

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-196124

(P2002-196124A)

(43) 公開日 平成14年7月10日 (2002.7.10)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 2 B 5/20	1 0 1	G 0 2 B 5/20	1 0 1 2 H 0 4 8
G 0 2 F 1/1335	5 0 5	G 0 2 F 1/1335	5 0 5 2 H 0 9 1
G 0 9 F 9/30	3 4 9	G 0 9 F 9/30	3 4 9 B 5 C 0 9 4

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願2000-390417(P2000-390417)

(22) 出願日 平成12年12月22日 (2000. 12. 22)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 有賀 久

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 片上 悟

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(74) 代理人 100095728

弁理士 上柳 雅彦 (外1名)

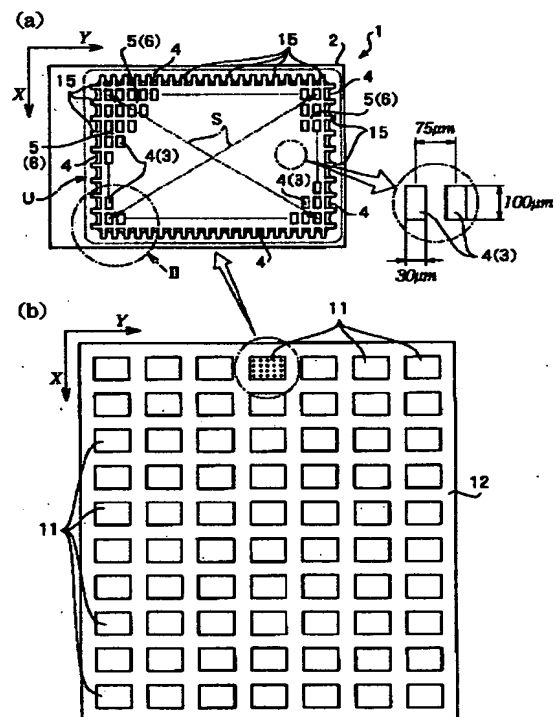
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カラーフィルタ基板、カラーフィルタ基板の製造方法及び液晶装置

(57) 【要約】

【課題】 カラーフィルタ基板の基材表面において保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く且つ無秩序に流れ出ることを防止する。

【解決手段】 基材2と、基材2の表面に形成された複数の色絵素3と、それらの色絵素3の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように基材2の表面に形成された複数の隔壁15と、複数の色絵素3の間及びそれらの上のいずれか一方又は両方に形成された保護膜4とを有するカラーフィルタ基板である。色絵素形成領域Sの外縁部において保護膜4は、隔壁15の働きにより無秩序に外側へ流れ出て広がることを防止される。



BEST AVAILABLE COPY

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材と、

該基材の表面に形成された複数の色絵素と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、
前記複数の色絵素の間及びそれらの上のいずれか一方又
は両方に形成された保護膜とを有することを特徴とする
カラーフィルタ基板。

【請求項2】 基材と、

該基材の表面に形成されて該基材を複数の領域に区画す
る区画材と、
前記複数の領域内に形成された複数の色絵素と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、
前記複数の色絵素の上に形成された保護膜とを有するこ
とを特徴とするカラーフィルタ基板。

【請求項3】 請求項1又は請求項2において、前記隔
壁はシール材形成領域の内側に在ることを特徴とするカ
ラーフィルタ基板。

【請求項4】 請求項1から請求項3の少なくともいず
れか1つにおいて、前記隔壁は電極配線形成領域以外の
領域に形成されることを特徴とするカラーフィルタ基
板。

【請求項5】 請求項1から請求項4の少なくともいず
れか1つにおいて、前記隔壁は前記色絵素ごとに設けら
れることを特徴とするカラーフィルタ基板。

【請求項6】 請求項1から請求項4の少なくともいず
れか1つにおいて、前記隔壁は前記色絵素又は前記区画
材と同じ材料によって形成されることを特徴とするカラー
フィルタ基板。

【請求項7】 基材上に複数の色絵素を形成する色絵素
形成工程と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材上に複数の隔壁を形成する隔壁形成
工程と、
前記隔壁形成工程の後に前記複数の色絵素の間及びそれ
らの上のいずれか一方又は両方に保護膜を形成する保護
膜形成工程とを有することを特徴とするカラーフィルタ
基板の製造方法。

【請求項8】 基材の表面を複数の領域に区画する区画
材を該基材上に形成する区画材形成工程と、
前記複数の領域に色絵素を形成する色絵素形成工程と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材上に複数の隔壁を形成する隔壁形成
工程と、
前記隔壁形成工程の後に前記複数の色絵素の上に保護膜
を形成する保護膜形成工程とを有することを特徴とする
カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項9】 請求項7又は請求項8において、前記隔
壁形成工程では前記隔壁はシール材形成領域の内側に形

2

成されることを特徴とするカラーフィルタ基板の製造方
法。

【請求項10】 請求項7から請求項9の少なくともい
ずれか1つにおいて、前記隔壁形成工程では前記隔壁は
電極配線形成領域以外の領域に形成されることを特徴と
するカラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項11】 請求項7から請求項10の少なくとも
いずれか1つにおいて、前記隔壁形成工程では前記隔壁
は前記色絵素ごとに形成されることを特徴とするカラー
フィルタ基板の製造方法。

【請求項12】 請求項7から請求項11の少なくとも
いずれか1つにおいて、前記隔壁形成工程は前記色絵素
形成工程と同時に又は前記区画材形成工程と同時に行わ
れることを特徴とするカラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項13】 請求項7から請求項12の少なくとも
いずれか1つにおいて、前記保護膜は液体であることを
特徴とするカラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項14】 液晶を挟持する一対の基板と、少なく
とも一方の基板に形成されるカラーフィルタ基板とを有
する液晶装置において、前記カラーフィルタ基板は、
基材と、

該基材の表面に形成された複数の色絵素と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、
前記複数の色絵素の間及びそれらの上のいずれか一方又
は両方に形成された保護膜とを有することを特徴とする
液晶装置。

【請求項15】 液晶を挟持する一対の基板と、少なく
とも一方の基板に形成されるカラーフィルタ基板とを有
する液晶装置において、前記カラーフィルタ基板は、
基材と、

該基材の表面に形成されて該基材を複数の領域に区画す
る区画材と、
前記複数の領域内に形成された複数の色絵素と、
それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び
出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、
前記複数の色絵素の上に形成された保護膜とを有するこ
とを特徴とする液晶装置。

【請求項16】 請求項14又は請求項15において、
前記隔壁はシール材形成領域の内側に在ることを特徴と
する液晶装置。

【請求項17】 請求項14から請求項16の少なくと
もいずれか1つにおいて、前記隔壁は電極配線形成領域
以外の領域に形成されることを特徴とする液晶装置。

【請求項18】 請求項14から請求項17の少なくと
もいずれか1つにおいて、前記隔壁は前記色絵素ごとに
設けられることを特徴とする液晶装置。

【請求項19】 請求項14から請求項18の少なくと
もいずれか1つにおいて、前記隔壁は前記色絵素又は前
記区画材と同じ材料によって形成されることを特徴とする

(3)

3

液晶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、R、G、B又はC、M、Y等といった複数の色絵素を基材上に形成して成るカラーフィルタ基板及びその製造方法に関する。また、本発明は、そのカラーフィルタ基板を用いて構成される液晶装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、携帯電話機、携帯型パーソナルコンピュータ等といった電子機器に液晶装置が広く用いられるようになってきている。また、カラーフィルタ基板を用いてカラー表示を行う構造の液晶装置も広く用いられるようになってきた。

【0003】カラーフィルタ基板として、従来、例えば図22(a)に示すように、ガラス、プラスチック等によって形成された基材201の表面に、例えばR(赤)、G(緑)、B(青)のそれぞれの色絵素202を所定の配列、例えばストライプ配列、モザイク配列、デルタ配列等に形成して成るものが知られている。色絵素202に関しては、例えば図22(c)に示すように、R色絵素202R、G色絵素202G、B色絵素202Bが互いに隣り合って形成される。そして、各色絵素202の間にはブラックマスク203が形成され、さらに色絵素202の上にスピンコート等によって保護膜204が形成される。なお、図22(a)では保護膜204の図示は省略してある。

【0004】保護膜204を形成する理由はいくつか考えられる。第1に、保護膜の形成によってカラーフィルタ基板の表面を平坦化することにより、そのカラーフィルタ基板の表面に電極が形成される際、その電極が切れることを防止するためである。第2に、保護膜上の電極の低抵抗化によって画素間のコントラスト比を向上させるためである。第3に、保護膜形成後に続いて行われる工程においてカラーフィルタ基板内の画素が傷付くことを防止すること、すなわち保護機能を果たすためである。第4に、カラーフィルタ基板が液晶装置に用いられる場合にセルギャップ内へ液晶が封入された後、カラーフィルタ基板から液晶へ不純物が拡散することを防止するためである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のカラーフィルタ基板200においては、図22(b)に示すように、保護膜204が色絵素202の形成領域Sの外側の遠くまで流れて広がるという問題があった。また、図22(c)に符号Wで示すように最外縁の色絵素202の所で保護膜204に急峻な段差が形成されるという問題もあった。

【0006】ここで、カラーフィルタ基板200が液晶装置の構成要素として用いられる場合を考えると、カラ

4

ーフィルタ基板200の表面には各色絵素202の上を通過するようにITO(Indium Tin Oxide)等によって透明電極205が形成され、さらにカラーフィルタ基板200に対向基板を貼り合わせるためのシール材206がカラーフィルタ基板200の周辺に形成又は接着される。

【0007】従来のカラーフィルタ基板200において上記のように保護膜204が色絵素202の形成領域Sの外側へ広く広がると、保護膜204がシール材206の下へ入り込み、シール材206の剥がれ等といった支障が生じるおそれがあった。また、上記のように保護膜204の外縁に急峻な段差が発生すると、保護膜204の上に形成される電極205がその段差部分で切断するおそれがあった。

【0008】本発明は、上記の問題点を鑑みて成されたものであって、カラーフィルタ基板の基材表面において保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く且つ無秩序に流れ出ることを防止することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】(1)上記の目的を達成するため、本発明に係る第1のカラーフィルタ基板は、基材と、該基材の表面に形成された複数の色絵素と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、前記複数の色絵素の間及びそれらの上のいずれか一方又は両方に形成された保護膜とを有することを特徴とする。

【0010】この第1のカラーフィルタ基板によれば、複数の色絵素の間やそれらの上に供給された保護膜は前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0011】(2)次に、本発明に係る第2のカラーフィルタ基板は、基材と、該基材の表面に形成されて該基材を複数の領域に区画する区画材と、前記複数の領域内に形成された複数の色絵素と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、前記複数の色絵素の上に形成された保護膜とを有することを特徴とする。

【0012】この第2のカラーフィルタ基板が先の第1のカラーフィルタ基板と異なる点は、基材の表面に区画材が形成され、この区画材によって区画された複数の領域内に色絵素が形成されることである。この第2のカラーフィルタ基板によれば、複数の色絵素の間には区画材が存在するので、保護膜は色絵素の間に形成されることはなく、保護膜は色絵素の上に形成される。

【0013】この第2のカラーフィルタ基板によれば、

50

(4)

5

複数の色絵素の上に供給された保護膜は前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0014】上記第1及び第2のカラーフィルタ基板において、前記隔壁はシール材形成領域の内側に在ることが望ましい。ここで又はこれ以降、シール材とは、本カラーフィルタ基板を他の1つの基板に貼り合わせることによって例えば液晶装置を形成する場合に、それらの基板の間に介在してそれらの基板を貼り合わせてそれらの基板の間に外部から封止されたシール領域、すなわちセルギャップを形成するための部材である。以上のように隔壁をシール材形成領域の内側に存在させることにすれば、保護膜がシール材の下側へ入り込むことを確実に防止できる。

【0015】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板において、前記隔壁は電極配線形成領域以外の領域に形成されることが望ましい。ここで又はこれ以降、電極とは、本カラーフィルタ基板を他の1つの基板に貼り合わせることによって例えば液晶装置を形成する場合に、液晶装置の有効表示領域内に在って液晶に電圧を印加するための電極である。また、電極配線とは、上記電極につながっていて上記液晶装置の有効表示領域の外側へ延び出る配線部分のことである。以上のように隔壁を電極配線形成領域以外の領域に形成することにすれば、電極配線は段差の緩やかな個所を通ることになるので、電極配線の断線を確実に防止できる。

【0016】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板において、前記隔壁は前記色絵素ごとに設けられることが望ましい。つまり、隔壁は色絵素の1つごと、2つごと、3つごと、あるいはそれ以上の数ごとに形成されることが望ましい。

【0017】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板において、前記隔壁は前記色絵素又は前記区画材と同じ材料によって形成されることが望ましい。この構成によれば、隔壁は色絵素と同時に形成することもできるし、あるいは、区画材と同時に形成することもできる。

【0018】(3) 次に、本発明に係る第1のカラーフィルタ基板の製造方法は、基材上に複数の色絵素を形成する色絵素形成工程と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材上に複数の隔壁を形成する隔壁形成工程と、前記隔壁形成工程の後に前記複数の色絵素の間及びそれらの上のいずれか一方又は両方に保護膜を形成する保護膜形成工程とを有することを特徴とする。

【0019】この第1のカラーフィルタ基板の製造方法

6

によれば、保護膜形成工程において複数の色絵素の間やそれらの上に供給された保護膜は、隔壁形成工程において形成された前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0020】(4) 次に、本発明に係る第2のカラーフィルタ基板の製造方法は、基材の表面を複数の領域に区画する区画材を該基材上に形成する区画材形成工程と、前記複数の領域に色絵素を形成する色絵素形成工程と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材上に複数の隔壁を形成する隔壁形成工程と、前記隔壁形成工程の後に前記複数の色絵素の上に保護膜を形成する保護膜形成工程とを有することを特徴とする。

【0021】この第2のカラーフィルタ基板の製造方法が先の第1のカラーフィルタ基板の製造方法と異なる点は、区画材形成工程において基材の表面に区画材を形成し、色絵素形成工程では区画材によって区画された複数の領域内に色絵素を形成することである。この第2のカラーフィルタ基板によれば、複数の色絵素の間には区画材が存在するので、保護膜は色絵素の間に形成されることはなく、保護膜は色絵素の上に形成される。

【0022】この第2のカラーフィルタ基板の製造方法によれば、保護膜形成工程において複数の色絵素の上に供給された保護膜は、隔壁形成工程において形成された前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0023】上記第1又は第2のカラーフィルタ基板の製造方法において、前記隔壁形成工程では前記隔壁はシール材形成領域の内側に形成されることが望ましい。こうすれば、保護膜がシール材の下側へ入り込むことを確実に防止できる。

【0024】また、上記第1又は第2のカラーフィルタ基板の製造方法において、前記隔壁形成工程では前記隔壁は電極配線形成領域以外の領域に形成されることが望ましい。こうすれば、電極配線は段差の緩やかな個所を通ることになるので、電極配線の断線を確実に防止できる。

【0025】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板の製造方法において、前記隔壁形成工程では前記隔

(5)

7

壁は前記色絵素ごとに形成されることが望ましい。つまり、隔壁は色絵素の1つごと、2つごと、3つごと、あるいはそれ以上の数ごとに形成することが望ましい。

【0026】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板の製造方法において、前記隔壁形成工程は前記色絵素形成工程と同時に又は前記区画材形成工程と同時に行われることが望ましい。これにより、隔壁を形成するために特別な工程を設ける必要がなくなる。

【0027】また、上記第1及び第2のカラーフィルタ基板の製造方法において、前記保護膜は液体であることが望ましい。通常、保護膜はアクリル樹脂、エポキシ樹脂、イミド系樹脂又はフッ素系樹脂等によって形成することができる。本発明では、インクジェット法やスピコート法等によって保護膜を形成することが望ましく、このため、保護膜は液体であることが望ましい。

【0028】(5) 次に、本発明に係る第1の液晶装置は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板に形成されるカラーフィルタ基板とを有する液晶装置において、前記カラーフィルタ基板は、基材と、該基材の表面に形成された複数の色絵素と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、前記複数の色絵素の間及びそれらの上のいずれか一方又は両方に形成された保護膜とを有することが望ましい。

【0029】この第1の液晶装置によれば、その構成要素であるカラーフィルタ基板において、複数の色絵素の間やそれらの上に供給された保護膜は前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。この結果、液晶装置による表示品質を長期間にわたって高く維持できる。

【0030】(6) 次に、本発明に係る第2の液晶装置は、液晶を挟持する一対の基板と、少なくとも一方の基板に形成されるカラーフィルタ基板とを有する液晶装置において、前記カラーフィルタ基板は、基材と、該基材の表面に形成されて該基材を複数の領域に区画する区画材と、前記複数の領域内に形成された複数の色絵素と、それらの色絵素の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように前記基材の表面に形成された複数の隔壁と、前記複数の色絵素の上に形成された保護膜とを有することを特徴とする。

【0031】この第2の液晶装置が先の第1の液晶装置と異なる点は、カラーフィルタ基板において、基材の表面に区画材が形成され、この区画材によって区画された複数の領域内に色絵素が形成されることである。この第2の液晶装置によれば、カラーフィルタ基板において、

8

複数の色絵素の間には区画材が存在するので、保護膜は色絵素の間に形成されることはなく、保護膜は色絵素の上に形成される。

【0032】この第2の液晶装置によれば、カラーフィルタ基板において、複数の色絵素の上に供給された保護膜は前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。この結果、液晶装置による表示品質を長期間にわたって高く維持できる。

【0033】上記第1又は第2の液晶装置において、前記隔壁はシール材形成領域の内側に在ることが望ましい。こうすれば、保護膜がシール材の下側へ入り込むことを確実に防止できる。

【0034】また、上記第1又は第2の液晶装置において、前記隔壁は電極配線形成領域以外の領域に形成されることが望ましい。こうすれば、電極配線は段差の緩やかな箇所を通ることになるので、電極配線の断線を確実に防止できる。

【0035】また、上記第1又は第2の液晶装置において、前記隔壁は前記色絵素ごとに設けられることが望ましい。つまり、隔壁は色絵素の1つごと、2つごと、3つごと、あるいはそれ以上の数ごとに形成することが望ましい。

【0036】また、上記第1又は第2の液晶装置において、前記隔壁は前記色絵素又は前記区画材と同じ材料によって形成されることが望ましい。この構成によれば、隔壁は色絵素と同時に形成することもできるし、あるいは、区画材と同時に形成することもできる。

【0037】

【発明の実施の形態】(第1実施形態)図1(a)は本発明に係るカラーフィルタ基板の一実施形態の平面構造を示している。また、図2(b)は図1(a)における矢印IIで示す部分を拡大して示している。また、図3(a)は図2(b)におけるIII-III線に従った断面構造を示している。

【0038】本実施形態のカラーフィルタ基板1は、図3(a)に示すように、ガラス、プラスチック等によって形成された基材2と、その基材2の表面に形成されたブラックマスク6と、そのブラックマスク6の上に形成された区画材としてのバンク5と、そのバンク5によって囲まれる領域に形成された複数の色絵素3と、同じくバンク5によって囲まれる領域であって色絵素3の上に重ねて形成された保護膜4とを有する。

【0039】バンク5及びその下層のブラックマスク6は図1(a)において色絵素3及び保護膜4を形成する

(6)

9

部分を格子穴とする格子状に形成され、保護膜4及びその下層の色絵素3はそれらの格子穴を埋めるように形成される。これにより、複数の色絵素3は基材2の表面にドットパターン状、本実施形態ではドット・マトリクス状に形成される。

【0040】ブラックマスク6は透光性のない樹脂材料によって形成される。バンク5は、ブラックマスク6を別個に設ける場合には、透光性のない樹脂又は透光性のある樹脂のいずれかによって形成される。また、バンク5を透光性のない樹脂によって形成する場合には、そのバンク5によってブラックマスクの機能を兼用することもできる。

【0041】複数の色絵素3は、それぞれが、例えば、R（赤）、G（緑）、B（青）のうちのいずれか1色の色材によって形成され、それらの各色絵素3が所定の配列に並べられている。図3（a）ではR色絵素を3Rで、G色絵素を3Gで、B色絵素を3Bで、それぞれ示している。

【0042】各色絵素3R、3G、3Bの配列としては、例えば、図4（a）に示すストライプ配列、図4（b）に示すモザイク配列、図4（c）に示すデルタ配列等が知られている。ストライプ配列は、マトリクスの縦列が全て同色になる配色である。モザイク配列は、縦横の直線上に並んだ任意の3つの色絵素がR、G、Bの3色となる配色である。そして、デルタ配列は、色絵素の配置を段違いにし、任意の隣接する3つの色絵素がR、G、Bの3色となる配色である。

【0043】図1（a）において、カラーフィルタ基板1の大きさは、例えば、対角寸法が1.8インチである。また、1個の色絵素3の大きさは、例えば、 $30\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$ である。また、各色絵素3の間の間隔、いわゆるエレメント間ピッチは、例えば、 $75\mu\text{m}$ である。

【0044】本実施形態では、各色絵素3R、3G、3Bの高さすなわち厚さは、図3（a）に示すように、バンク5よりも薄く形成され、さらに各厚さはそれぞれ異なっている。具体的には、G色絵素3Gが最も厚く、R色絵素3Rがその次に厚く、B色絵素3Bが最も薄く形成されている。このように各色絵素間で厚さが異なるのは、主としては、観察者の希望に応じて特定色を強調したり又は弱めたりするためである。また、視覚的に解像力に影響の大きいG色絵素3Gを他の色絵素よりも低く形成する等といった厚さ制御が行われることもある。

【0045】また、色絵素3の上に重ねて形成される保護膜4に関しては、G色絵素3Gに対応する保護膜4の厚さは最も薄く、R色絵素3Rに対応する保護膜4はその次に薄く、B色絵素3Bに対応する保護膜4は最も厚く形成される。そして、そのような厚さ制御により、各色絵素3に重ねて形成された保護膜4の頂面の高さはバンク5の高さとほぼ等しくなっている。

10

【0046】この場合の「ほぼ等しい」とは、保護膜4とバンク5の高さが物理的に完全に同一の場合を含むことはもとより、製造上の誤差や製造上の不可避の理由により、それらの高さがわずかに違っている場合でも、保護膜4が機能的に同様に作用できるときには、そのような高さの違いも含む意味である。

【0047】なお、保護膜4は必ずしもその高さがバンク5の高さとほぼ等しく形成されていなくても良い。この場合でも、色絵素3の損傷を防止する保護機能や、液晶への不純物の拡散防止等といった機能は保護膜4によって達成できる。

【0048】本実施形態では、図1（a）に示すように、複数の色絵素3の最外縁に在るもののさらに外側へ延び出すように複数の隔壁15が基材2の表面に形成されている。また、これらの隔壁15はシール材が形成される領域又はシール材が接着される領域（以下、シール材形成領域という）Uの内側領域に止まるように形成される。本実施形態では隔壁15は、図3（a）及び図2（b）に示すように、バンク5から一体に延び出るように、つまりバンク5と同じ材料によって形成されている。具体的には、例えば、バンク5をパターニングする際に同時にパターニングされて形成される。

【0049】また、保護膜4は、各色絵素3の上に重ねて形成されることに加えて、隣り合う隔壁15の間にも形成される。このような隔壁15間の保護膜4は、例えば、各色絵素3の上にスピンコート法を用いて保護膜4を形成する場合には、そのスピンコート処理時に隔壁15間に供給される。他方、各色絵素3の上にインクジェット法を用いて保護膜4を形成する場合には、各隔壁15間の保護膜4はそれらの隔壁15間を狙ってインクすなわち保護膜材料をドット状のインク滴として所定量、吐出することによって形成される。

【0050】各隔壁15間に供給された保護膜材料によって形成された保護膜4は、図2（b）に示すように、隔壁15との間の表面張力等に起因して外部への流出が規制されて、図2（b）に符号204で示した従来の保護膜で見られたような外側方向へ向かう無秩序な外縁の広がりを呈することなく、比較的小さくて均一な広がりを呈することになる。

【0051】このため、例えば、本カラーフィルタ基板1を液晶装置を構成する一方の基板として用いたときに、保護材4はその外縁がシール材形成領域Uまで広がって流れることがなくなり、よって、シール材形成領域等Uに形成されるシール材108の下層に保護膜4が流れ込んでシール材108のシール性を劣化させる等といった不都合を解消できる。

【0052】本実施形態のカラーフィルタ基板1を例えば液晶装置におけるカラーフィルタ基板として用いる場合を考えれば、図3（a）において色絵素3の表面には電極13が設けられる。このとき、色絵素3を形成した

(7)

11

カラーフィルタ基板1の表面に凹凸があると電極に段差ができて、その電極が切断されるおそれがある。これに対し、保護膜4を設けることにより表面が滑らかに形成された本実施形態のカラーフィルタ基板1によれば、そのような電極の切断を確実に防止できる。

【0053】また、隔壁15の間に供給された保護膜材料によって形成された保護膜4は、それらの隔壁15が在ることにより、図22(c)において符号204で示した従来の保護膜の場合のように最外縁に在る色絵素202の所で急峻に段差を形成するのではなく、図3

(a)に符号Tで示すように、緩やかなテーパ状に形成される。

【0054】このため、例えば、本カラーフィルタ基板1を液晶装置を構成する一方の基板として用いたときに、カラーフィルタ基板1の表面に形成される電極13の配線部分が色絵素形成領域Sの外縁部で大きな曲率で曲がることを回避でき、そのため、電極の切断を確実に防止できる。

【0055】なお、図1(a)に示す実施形態では隔壁15を縦方向(X方向)及び横方向(Y方向)のいずれに関して色絵素3の1つごとに形成したが、これに代えて、色絵素3の2つごと、あるいはそれ以上の数ごとに形成しても良い。また、図2(b)において電極13が配線となってシール材形成領域Uの外側へ引き出される側、図2(b)では左辺側、に在る隔壁15に関しては、それらの隔壁15は電極13から延びる配線が形成される領域以外の領域に形成されている。つまり、複数の隔壁15は電極配線を避ける位置、換言すれば電極配線を挟む位置に形成される。また、電極配線が形成されない側、図2(b)では下辺側、に在る隔壁15に関しては、それらの隔壁15を形成する位置は電極13とは無関係である。

【0056】以上のような構成から成る本実施形態に係るカラーフィルタ基板1をフルカラー表示のための光学要素として用いる場合には、R、G、B3個の色絵素3を1つのユニットとして1つの画素を形成し、1画素内のR、G、Bのいずれか1つ又はそれらの組み合わせに光を選択的に通過させることにより、フルカラー表示を行う。このとき、透光性のない樹脂材料によって形成されたブラックマスク6は色絵素3以外の部分から光が漏れるのを防止する。

【0057】図3(a)に示すカラーフィルタ基板1は、例えば、図1(b)に示すような大面積のマザー基材12から切り出される。具体的には、まず、マザー基材12内に設定された複数のカラーフィルタ形成領域11のそれぞれの表面にカラーフィルタ基板1の1個分のパターンを形成し、さらにそれらのカラーフィルタ形成領域11の周りに切断用の溝を形成し、さらにそれらの溝に沿ってマザー基材12を切断することにより、個々のカラーフィルタ基板1が形成される。

12

【0058】以下、図1(a)に示すカラーフィルタ基板1を製造する製造方法及びその製造装置について説明する。

【0059】図5はカラーフィルタ基板1の製造方法を工程順に模式的に示している。まず、ガラス、プラスチック等によって形成されたマザー基材12の表面に透光性のない樹脂材料、例えばCr(クロム)によってブラックマスク6を矢印B方向から見て格子状パターンに形成する。格子状パターンの格子穴の部分7は色絵素3が形成される領域、すなわち色絵素形成領域である。このブラックマスク6によって形成される個々の色絵素形成領域7の矢印B方向から見た場合の平面寸法は、例えば30 μ m×100 μ m程度に形成される。

【0060】ブラックマスク6は任意の成膜手法、例えばスパッタリングによって材料、例えばCr等を0.1～0.2 μ m程度の均一な厚さで一様に形成した後、適宜のパターニング手法、例えばフォトリソグラフィー法によって格子状パターンに形成される(工程P1)。ブラックマスク6の形成後、工程P2においてバンク5を形成する。具体的には、望ましくは撥インク性の樹脂を例えばスピンコート法を用いて所定の厚さに形成して、さらに適宜のパターニング手法例えばフォトリソグラフィー法を用いて所定の格子状に形成する。このバンク形成の際、それと同時に色絵素形成領域Sの外縁部に複数の隔壁15を互いに間隔を開けて形成する。

【0061】その後、工程P3において、バンク5によって区画された各領域内にインクジェット法を用いてR、G、Bの色絵素3を形成する。具体的には、インクジェットヘッド22によってマザー基材12の表面を走査しながら、インクジェットヘッド22に設けたノズル27から色絵素材料8を図4のいずれかに示す配列パターンに対応した所定のタイミングでインク滴として吐出してマザー基材12上に付着させる。そして、焼成処理又は紫外線照射処理により色絵素材料を固化して色絵素3を形成する。この処理を各色絵素3R、3G、3Bごとに繰り返すことによって希望の配列の色絵素パターンを形成する。

【0062】その後、工程P4において、バンク5によって区画された各領域内であって色絵素3の上にインクジェット法を用いて保護膜4を形成する。具体的には、色絵素3の場合と同様にして、インクジェットヘッド22によってマザー基材12の表面を走査しながら、インクジェットヘッド22に設けたノズル27から保護膜材料10を図4のいずれかに示す配列パターンに対応した所定のタイミングで図2(a)に示すようにインク滴10として吐出してマザー基材12上の各色絵素3の上に供給する。このとき、保護膜材料10は複数の隔壁15の間にも供給される。

【0063】そしてその後、例えば200℃、30分～60分の焼成処理により保護膜材料を固化して図2

(8)

13

(b)に示すように保護膜4を成膜する。なお、隔壁15の延び出し長さ及び高さは、保護膜4の材料の物性、例えば粘度、表面張力等に応じて適切に設定される。

【0064】複数の隔壁15の間にも所定量の保護膜材料10がインクドット状に供給されることにより、緩やかにテーパ状に低くなりながら広がる保護膜4がその外縁が大きく広がらない状態で色絵素形成領域Sの外縁部に形成される。

【0065】なお、色絵素形成工程P3におけるインクジェット処理では、色絵素3のR、G、B各色ごとにインクジェットヘッド22の走査を繰り返して色絵素を形成するか、あるいは、1つのインクジェットヘッド22にR、G、B3色のノズルを設備しておいて1回の走査によってR、G、B3色を同時に形成することもできる。

【0066】一方、保護膜形成工程P4におけるインクジェット処理では、バンク5によって形成される複数の格子状穴の全てへインクジェットヘッド22の1回の走査期間中、場合によっては複数の走査期間中に所定量のインク滴を供給する。但し、格子状穴の中に形成されている色絵素3の厚さがR、G、Bの色ごとに異なっている場合には、ノズル27から吐出するインクの吐出量も色ごとに適量に調節する。

【0067】色絵素形成工程P3で用いるインクジェットヘッド22と保護膜形成工程P4で用いるインクジェットヘッド22は同一のインクジェット装置に交換して装着することにしても良いし、あるいは、それぞれを別のインクジェット装置に装着しておいてそれらのインクジェット装置を個別に使用することにしても良い。また、場合によっては、インクジェットヘッド22及びそれを装着するインクジェット装置として同じものを使用し、その同一のインクジェットヘッド22へ供給するインクを色絵素材料と保護膜材料との間で交換するような方法も採用できる。

【0068】なお、色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4におけるインクジェットヘッド22によるマザー基材12の走査方法は特別な方法に限定されるものでなく種々に考えられる。例えば、複数のノズル27をマザー基材12の一辺とほぼ同じ長さに並べてノズル列を構成し、1回の走査によってマザー基材12の全面に絵素材料8や保護膜材料10を供給する方法や、マザー基材12の一辺よりも短い長さのノズル列を有するインクジェットヘッド22に関してインクを吐出するための主走査及び主走査位置をずらせるための副走査を繰り返して行うことによってマザー基材12の全面にインクを供給する方法等が考えられる。

【0069】図6は、図5の色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4を実施するための装置の一例であるインクジェット装置の一実施形態を示している。このインクジェット装置16は色絵素材料又は保護膜材料をイン

14

クの液滴として、マザー基材12（図1（b）参照）内の各カラーフィルタ形成領域11内の所定位置に吐出して付着させるための装置である。

【0070】図6において、インクジェット装置16は、インクジェットヘッド22を備えたヘッドユニット26と、インクジェットヘッド22の位置を制御するヘッド位置制御装置17と、マザー基材12の位置を制御する基板位置制御装置18と、インクジェットヘッド22をマザー基材12に対して主走査移動させる主走査駆動装置19と、インクジェットヘッド22をマザー基材12に対して副走査移動させる副走査駆動装置21と、マザー基材12をインクジェット装置16内の所定の作業位置へ供給する基板供給装置23と、そしてインクジェット装置16の全般の制御を司るコントロール装置24とを有する。

【0071】ヘッド位置制御装置17、基板位置制御装置18、主走査駆動装置19、そして副走査駆動装置21の各装置はベース9の上に設置される。また、それらの各装置は必要に応じてカバー14によって覆われる。

【0072】インクジェットヘッド22は、例えば図8（a）に示すように、複数、本実施形態では6個のヘッド部20と、それらのヘッド部20を並べて支持する支持手段としてのキャリッジ25とを有する。キャリッジ25は、ヘッド部20を支持すべき位置にヘッド部20よりも少し大きい穴すなわち凹部を有し、各ヘッド部20はそれらの穴の中に入れられ、さらにネジ、接着剤その他の締結手段によって固定される。また、キャリッジ25に対するヘッド部20の位置が正確に決められる場合には、特別な締結手段を用いることなく、単なる圧入によってヘッド部20を固定しても良い。

【0073】ヘッド部20は、図8（b）に示すように、複数のノズル27を列状に並べることによって形成されたノズル列28を有する。ノズル27の数は例えば180個であり、ノズル27の穴径は例えば28 μ mであり、ノズル27間のノズルピッチは例えば141 μ mである。図1（a）及び図1（b）において基材2及びマザー基材12に対する主走査方向はX方向であり、それに直交するY方向が副走査方向であり、それらのX方向及びY方向は図8（a）においてインクジェットヘッド22に対して図示の通りに設定される。

【0074】インクジェットヘッド22はX方向へ平行移動することによりマザー基材12を主走査するが、この主走査の間にインクとしての色絵素材料又は保護膜材料を各ヘッド部20内の複数のノズル27から選択的に吐出することにより、マザー基材12内の所定位置に色絵素材料又は保護膜材料を付着させる。また、インクジェットヘッド22は副走査方向Yへ所定距離、例えばノズル列28の1列分の長さL又はその整数倍だけ平行移動することにより、インクジェットヘッド22による主走査位置を所定の間隔でずらせることができる。

(9)

15

【0075】各ヘッド部20のノズル列28は、各ヘッド部20がキャリッジ25に取り付けられたときに一直線Zに載るように設定される。また、隣り合う各ヘッド部20の間隔Dは、隣り合う一対のヘッド部20のそれぞれに属する最端位置のノズル27同士間の距離が個々のヘッド部20内のノズル列28の長さLに等しくなるように設定される。ノズル列28に関するこのような配置はインクジェットヘッド22に関するX方向の主走査制御及びY方向に関する副走査制御を簡単にするための措置であり、ノズル列28の配置形態すなわちヘッド部20のキャリッジ25に対する配列形態は上記以外に任意に設定可能である。

【0076】個々のヘッド部20は、例えば、図10

(a)及び図10(b)に示す内部構造を有する。具体的には、ヘッド部20は、例えばステンレス製のノズルプレート29と、それに対向する振動板31と、それらを互いに接合する複数の仕切部材32とを有する。ノズルプレート29と振動板31との間には、仕切部材32によって複数のインク室33と液溜り34とが形成される。複数のインク室33と液溜り34とは通路38を介して互いに連通している。

【0077】振動板31の適所にはインク供給穴36が形成され、このインク供給穴36にインク供給装置37が接続される。このインク供給装置37は色絵素材料M又は保護膜材料Mをインク供給穴36へ供給する。供給された色絵素材料M又は保護膜材料Mは液溜り34に充填し、さらに通路38を通過してインク室33に充填する。色絵素材料Mに関しては、インク供給装置37から供給されるものはR、G、Bのいずれか1色であり、個々の色に対してそれぞれ異なったヘッド部20が準備される。

【0078】なお、色絵素材料MはR、G、Bの各色色材を溶媒に分散させることによって形成される。また、保護膜材料Mは、透光性を有する熱硬化型樹脂又は光硬化型樹脂であって、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、イミド系樹脂又はフッ素系樹脂の少なくとも1つを含んで形成できる。また、保護膜材料Mの粘度は望ましくは10cps～50cpsに設定される。これは、10cps未満では流動性が高過ぎて特定形状に形成することが難しくなること及び50cpsを超える場合にはノズル27から一定量を吐出することが難しくなるからである。

【0079】ノズルプレート29には、インク室33から色絵素材料M又は保護膜材料Mをジェット状に噴射するためのノズル27が設けられている。また、振動板31のインク室33を形成する面の裏面には、該インク室33に対応させてインク加圧体39が取り付けられている。このインク加圧体39は、図10(b)に示すように、圧電素子41並びにこれを挟持する一対の電極42a及び42bを有する。圧電素子41は電極42a及び

16

42bへの通電によって矢印Cで示す外側へ突出するように撓み変形し、これによりインク室33の容積が増大する。すると、増大した容積分に相当する色絵素材料M又は保護膜材料Mが液溜り34から通路38を通過してインク室33へ流入する。

【0080】次に、圧電素子41への通電を解除すると、該圧電素子41と振動板31は共に元の形状へ戻る。これにより、インク室33も元の容積に戻るためインク室33の内部にある色絵素材料M又は保護膜材料Mの圧力が上昇し、ノズル27からマザー基材12(図1(b)参照)へ向けて色絵素材料M又は保護膜材料Mが液滴8、10となって噴出する。なお、ノズル27の周辺部には、液滴8、10の飛行曲がりやノズル27の穴詰まり等を防止するために、例えばNi-テトラフルオロエチレン共析メッキ層から成る撥インク層43が設けられる。

【0081】図7において、ヘッド位置制御装置17は、インクジェットヘッド22を面内回転させる α モータ44と、インクジェットヘッド22を副走査方向Yと平行な軸線回りに揺動回転させる β モータ46と、インクジェットヘッド22を主走査方向Xと平行な軸線回りに揺動回転させる γ モータ47と、そしてインクジェットヘッド22を上下方向へ平行移動させるZモータ48とを有する。

【0082】図6に示した基板位置制御装置18は、図7において、マザー基材12を載せるテーブル49と、そのテーブル49を矢印 θ のように面内回転させる θ モータ51とを有する。また、図6に示した主走査駆動装置19は、図7に示すように、主走査方向Xへ延びるガイドレール52と、パルス駆動されるリニアモータを内蔵したスライダ53とを有する。スライダ53は内蔵するリニアモータが作動するときにガイドレール52に沿って主走査方向へ平行移動する。

【0083】また、図6に示した副走査駆動装置21は、図7に示すように、副走査方向Yへ延びるガイドレール54と、パルス駆動されるリニアモータを内蔵したスライダ56とを有する。スライダ56は内蔵するリニアモータが作動するときにガイドレール54に沿って副走査方向Yへ平行移動する。

【0084】スライダ53やスライダ56内においてパルス駆動されるリニアモータは、該モータに供給するパルス信号によって出力軸の回転角度制御を精細に行うことができ、従って、スライダ53に支持されたインクジェットヘッド22の主走査方向X上の位置やテーブル49の副走査方向Y上の位置等を高精細に制御できる。なお、インクジェットヘッド22やテーブル49の位置制御はパルスモータを用いた位置制御に限られず、サーボモータを用いたフィードバック制御や、その他任意の制御方法によって実現することもできる。

【0085】図6に示した基板供給装置23は、マザー

(10)

17

基材12を収容する基板収容部57と、マザー基材12を搬送するロボット58とを有する。ロボット58は、床、地面等といった設置面に置かれる基台59と、基台59に対して昇降移動する昇降軸61と、昇降軸61を中心として回転する第1アーム62と、第1アーム62に対して回転する第2アーム63と、第2アーム63の先端下面に設けられた吸着パッド64とを有する。吸着パッド64は空気吸引等によってマザー基材12を吸着できる。

【0086】図6において、主走査駆動装置19によって駆動されて主走査移動するインクジェットヘッド22の軌跡下であって副走査駆動装置21の一方の脇位置に、キャッピング装置76及びクリーニング装置77が配設される。また、他方の脇位置に電子天秤78が配設される。クリーニング装置77はインクジェットヘッド22を洗浄するための装置である。電子天秤78はインクジェットヘッド22内の個々のノズル27から吐出されるインクの液滴の重量をノズルごとに測定する機器である。そして、キャッピング装置76はインクジェットヘッド22が待機状態にあるときにノズル27の乾燥を防止するための装置である。

【0087】インクジェットヘッド22の近傍には、そのインクジェットヘッド22と一体に移動する関係でヘッド用カメラ81が配設される。また、ベース9上に設けた支持装置（図示せず）に支持された基板用カメラ82がマザー基材12を撮影できる位置に配置される。

【0088】図6に示したコントロール装置24は、プロセッサを収容したコンピュータ本体部66と、入力装置としてのキーボード67と、表示装置としてのCRT（Cathode Ray Tube）ディスプレイ68とを有する。上記プロセッサは、図11に示すように、演算処理を行うCPU（Central Processing Unit）69と、各種情報を記憶するメモリすなわち情報記憶媒体71とを有する。

【0089】図6に示したヘッド位置制御装置17、基板位置制御装置18、主走査駆動装置19、副走査駆動装置21、そして、インクジェットヘッド22内の圧電素子41（図10（b）参照）を駆動するヘッド駆動回路72の各機器は、図11において、入出力インターフェース73及びバス74を介してCPU69に接続される。また、基板供給装置23、入力装置67、ディスプレイ68、電子天秤78、クリーニング装置77及びキャッピング装置76の各機器も入出力インターフェース73及びバス74を介してCPU69に接続される。

【0090】メモリ71は、RAM（Random Access Memory）、ROM（Read Only Memory）等といった半導体メモリや、ハードディスク、CD-ROM読取り装置、ディスク型記憶媒体等といった外部記憶装置等を含む概念であり、機能的には、インクジェット装置16の動作の制御手順が記述されたプログラムソフトを記憶する記

18

憶領域や、図7における主走査方向Xへのスライダ53の主走査移動量及び副走査方向Yへのマザー基材12の副走査移動量を記憶するための記憶領域や、CPU69のためのワークエリアやテンポラリファイル等として機能する領域や、その他各種の記憶領域が設定される。

【0091】本実施形態のカラーフィルタ基板の製造方法では、図5の色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4の両方でインクジェット装置16が用いられる。これらの工程で用いられるインクジェット装置16は機能的にはほとんど同じ装置を用いることができる。

【0092】また、色絵素形成工程P3で使用されるインクジェット装置16に備えられる図11のメモリ71には、色絵素形成の全般の手順を規制するプログラムソフトと、図4の希望する色絵素配列を実現するR、G、B形成位置データと、R、G、Bの各位置に各色材料をどのくらいの量で供給するかを規定するR、G、B付着量データ等が記憶される。このR、G、B付着量データは、色別で規定することもできるし、マザー基材12上の座標位置との関連で規定することもできる。

【0093】色絵素形成用のインクジェット装置16に関するCPU69は、R、G、B形成位置データ及びR、G、B付着量データに基づいて、インクジェットヘッド22の主走査中に複数のノズル27のいずれから、いずれのタイミングでインク、すなわち色絵素材料を吐出するかを演算する。

【0094】他方、保護膜形成工程P4で使用されるインクジェット装置16に備えられる図11のメモリ71には、色絵素形成工程P3で使用されるインクジェット装置16の場合と同様に、保護膜形成の全般の手順を規制するプログラムソフトと、図4の希望する色絵素配列を実現するR、G、B形成位置データと、R、G、Bの各位置に各色材料をどのくらいの量で供給するかを規定するR、G、B付着量データ等が記憶される。

【0095】保護膜形成用のインクジェット装置16に関するCPU69は、R、G、B形成位置データ及びR、G、B付着量データに基づいて、インクジェットヘッド22の主走査中に複数のノズル27のいずれから、いずれのタイミングでインク、すなわち保護膜材料を吐出するかを演算する。例えば、図3（a）に示すように、保護膜4の頂面とバンク5の頂面とをほぼ等しくするように保護膜材料の吐出量を定める場合を考えれば、CPU69はバンク5によって形成される格子状穴の容積から色絵素3の容積を減算した容積を保護膜材料の吐出量として算出する。

【0096】もちろん、保護膜形成用のインクジェット装置16のためのメモリ71として、R、G、B付着量データを記憶しておくことに代えて、R、G、Bの個々の色絵素に対応させて具体的にどのくらいの量の保護膜を吐出するかを直接的に記憶しておくことも可能である。

(11)

19

【0097】図11のCPU69は、メモリ71内に記憶されたプログラムソフトに従って、マザー基材12の表面の所定位置にインク、すなわち色絵素材料又は保護膜材料を吐出するための制御を行うものであり、具体的な機能実現部として、クリーニング処理を実現するための演算を行うクリーニング演算部と、キャッピング処理を実現するためのキャッピング演算部と、電子天秤78（図6参照）を用いた重量測定を実現するための演算を行う重量測定演算部と、インクジェットによって色絵素材料又は保護膜材料を描画するための演算を行う描画演算部とを有する。

【0098】また、描画演算部を詳しく分割すれば、インクジェットヘッド22を描画のための初期位置へセットするための描画開始位置演算部と、インクジェットヘッド22を主走査方向Xへ所定の速度で走査移動させるための制御を演算する主走査制御演算部と、マザー基材12を副走査方向Yへ所定の副走査量だけずらせるための制御を演算する副走査制御演算部と、そして、インクジェットヘッド22内の複数のノズル27のうちのい

ずれを、どのタイミングで作動させてインクすなわち色絵素材料又は保護膜材料を吐出するかを制御するための演算を行うノズル吐出制御演算部等といった各種の機能演算部を有する。

【0099】なお、本実施形態では、上記の各機能をCPU69を用いてソフト的に実現することにしたが、上記の各機能がCPUを用いない単独の電子回路によって実現できる場合には、そのような電子回路を用いることも可能である。

【0100】以下、上記構成から成るインクジェット装置16の動作を図12に示すフローチャートに基づいて説明する。

【0101】オペレータによる電源投入によってインクジェット装置16が作動すると、まず、ステップS1において初期設定が実行される。具体的には、ヘッドユニット26や基板供給装置23やコントロール装置24等が予め決められた初期状態にセットされる。

【0102】次に、重量測定タイミングが到来すれば（ステップS2でYES）、図7のヘッドユニット26を主走査駆動装置19によって図6の電子天秤78の所まで移動させて（ステップS3）、ノズル27から吐出されるインクの量を電子天秤78を用いて測定する（ステップS4）。そして、個々のノズル27のインク吐出特性に合わせて、各ノズル27に対応する圧電素子41に印加する電圧を調節する（ステップS5）。

【0103】次に、クリーニングタイミングが到来すれば（ステップS6でYES）、ヘッドユニット26を主走査駆動装置19によってクリーニング装置77の所まで移動させて（ステップS7）、そのクリーニング装置77によってインクジェットヘッド22をクリーニング*

20

*する（ステップS8）。

【0104】重量測定タイミングやクリーニングタイミングが到来しない場合（ステップS2及びS6でNO）、あるいはそれらの処理が終了した場合には、ステップS9において、図6の基板供給装置23を作動させてマザー基材12をテーブル49へ供給する。具体的には、基板収容部57内のマザー基材12を吸着パッド64によって吸引保持し、次に、昇降軸61、第1アーム62及び第2アーム63を移動させてマザー基材12をテーブル49まで搬送し、さらにテーブル49の適所に予め設けてある位置決めピン50（図7参照）に押し付ける。なお、テーブル49上におけるマザー基材12の位置ズレを防止するため、空気吸引等の手段によってマザー基材12をテーブル49に固定することが望ましい。

【0105】次に、図6の基板用カメラ82によってマザー基材12を観察しながら、図7のθモータ51の出力軸を微小角度単位で回転させることによりテーブル49を微小角度単位で面内回転させてマザー基材12を位置決めする（ステップS10）。次に、図6のヘッド用カメラ81によってマザー基材12を観察しながらインクジェットヘッド22によって描画を開始する位置を演算によって決定し（ステップS11）、そして、主走査駆動装置19及び副走査駆動装置21を適宜に作動させてインクジェットヘッド22を描画開始位置へ移動する（ステップS12）。このとき、インクジェットヘッド22は、図13に示すように、各ヘッド部20のノズル列28の延在方向Zが主走査方向Xと直角の方向となるようにセットされる。

【0106】図12のステップS12でインクジェットヘッド22が描画開始位置に置かれると、その後、ステップS13でX方向への主走査が開始され、同時にインクの吐出が開始される。具体的には、図7の主走査駆動装置19が作動してインクジェットヘッド22が図13の主走査方向Xへ一定の速度で直線的に走査移動し、その移動中、色絵素材料又は保護膜材料を吐出すべき領域にノズル27が到達したときにそのノズル27からインクすなわち色絵素材料又は保護膜材料が吐出されて該領域が埋められる。

【0107】例えば、図5の色絵素形成工程P3を考えれば、図3（a）においてR色絵素3Rの吐出量を V_R 、G色絵素3Gの吐出量を V_G 、B色絵素3Bの吐出量を V_B としたとき、 $V_G > V_R > V_B \dots \dots$ （1）の吐出量で各色絵素がそれぞれの色に対応したインクジェット装置16を用いて形成される。

【0108】他方、図5の保護膜形成工程P4を考えたとき、既に上式（1）の状態で図3（a）に示すように各色絵素3が形成されているものとする、

B用保護膜材料>R用保護膜材料>G用保護膜材料 $\dots \dots$ （2）

(12)

21

の吐出量で保護膜4が1つのインクジェット装置16を用いて形成される。図13(b)は式(2)を満足するようにドット状の保護膜材料Mを各色絵素3R、3G、3Bの量に適した量でそれらの上に吐出する状態を示している。なお、このとき、図3(a)に示すように、複数の隔壁15の間にも保護膜材料が液滴として供給される。

【0109】図13において、インクジェットヘッド22がマザー基材12に対する1回の主走査を終了すると(ステップS14でYES)、そのインクジェットヘッド22は反転移動して初期位置へ復帰する(ステップS15)。そしてさらに、インクジェットヘッド22は、副走査駆動装置21によって駆動されて副走査方向Yへ予め決められた副走査量、例えば、1個のヘッド部20に属するノズル列28の1列分の長さ又はその整数倍だけ移動する(ステップS16)。そして次に、主走査及びインク吐出が繰り返して行われて、未だ色絵素3又は保護膜4が形成されていない領域に色絵素3又は保護膜4が形成される(ステップS13)。

【0110】以上のようなインクジェットヘッド22による色絵素3又は保護膜4の描画作業がマザー基材12の全領域に対して完了すると(ステップS17でYES)、ステップS18で基板供給装置23によって又は別の搬送機器によって、処理後のマザー基材12が外部へ排出される。その後、オペレータによって処理終了の指示がなされない限り(ステップS19でNO)、ステップS2へ戻って別のマザー基材12に対する保護膜材料の吐着作業を繰り返して行う。

【0111】オペレータから作業終了の指示があると(ステップS19でYES)、CPU69は図6においてインクジェットヘッド22をキャッピング装置76の所まで搬送して、そのキャッピング装置76によってインクジェットヘッド22に対してキャッピング処理を施す(ステップS20)。

【0112】以上により、カラーフィルタ基板1を構成する各色絵素3についてのバタニング又は保護膜4についてのバタニングが終了する。保護膜4についてのバタニングが終了すれば、ストライプ配列等といった希望のR、G、Bのドット配列を有するカラーフィルタ基板1(図1(a))が複数個形成されたマザー基材12が製造される。このマザー基材12をカラーフィルタ形成領域11ごとに切断することにより、1個のカラーフィルタ基板1が複数個切り出される。

【0113】なお、本カラーフィルタ基板1を液晶装置のカラー表示のために用いるものとすれば、本カラーフィルタ基板1の表面にはさらに電極や配向膜等がさらに積層されることになる。そのような場合、電極や配向膜等を積層する前にマザー基材12を切断して個々のカラーフィルタ基板1を切り出してしまうと、その後の電極等の形成工程が非常に面倒になる。よって、そのような

22

場合には、マザー基材12上でカラーフィルタ基板1が完成した後に、直ぐにマザー基材12を切断してしまうのではなく、電極形成や配向膜形成等といった必要な付加工程が終了した後にマザー基材12を切断することが望ましい。

【0114】以上のように本実施形態に係るカラーフィルタ基板及びその製造方法によれば、図3(a)において、複数の色絵素3の上に供給された保護膜4の材料は複数の隔壁15同士の間にも入り込む。このとき、隔壁15は保護膜4の材料が色絵素3の形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜4はその外縁が色絵素形成領域Sの外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜4がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0115】(第2実施形態)図3(b)は本発明に係るカラーフィルタ基板の他の実施形態の主要部の断面を示している。この図は、上述した実施形態のカラーフィルタ基板における図3(a)に相当する構造を示している。

【0116】本実施形態のカラーフィルタ基板1が図3(a)に示した実施形態と異なる点は、保護膜4の頂面とバンク5の頂面とが等しい高さに設定されるのではなく、保護膜4の頂面の方がバンク5の頂面よりも高い構造、すなわち保護膜4がバンク5及び色絵素3の全てを覆う構造になっていることである。

【0117】この構造のカラーフィルタ基板1が図5に示した製造方法によって形成できることは図3(a)の実施形態の場合と同じである。また、その製造方法における色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4の両方をインクジェット法に基づく成膜方法によって達成することも同じである。但し、保護膜形成工程P4においてノズル27から吐出する保護膜材料の量は図3(b)の実施形態の方が図3(a)の実施形態の場合よりも多くなると考えられる。

【0118】本実施形態の場合でも、色絵素形成領域Sの外縁部には保護膜4が、シール材形成領域Uに到達するまでに大きく広がることなく、緩やかなテーパ状に傾斜して形成される。従って、シール材のシール性が保護膜4によって損なわれたり、カラーフィルタ基板1の表面に形成される電極が色絵素形成領域Sの外縁部分において切断したりすることを確実に防止できる。

【0119】(第3実施形態)図9は、図8(b)に示すヘッド部20の改変例を示している。図8(b)に示したヘッド部20においては、ノズル列28が主走査方向Xに関して1列だけ設けられた。これに代えて、図9に示すヘッド部20ではノズル列28が主走査方向Xに関して複数列、本実施形態では2列設けられている。このヘッド部20を用いれば、図8(a)のキャリッジ2

(13)

23

5がX方向へ主走査するとき、その主走査方向Xに並んだ2個のノズル27によってインクを吐出できるので、色絵素材料及び保護膜材料の吐出量の制御の仕方を多用化できる。

【0120】(第4実施形態)図14は本発明に係るカラーフィルタ基板の製造方法の他の実施形態の主要工程を示しており、この工程は既に説明した先の実施形態における図13で示した工程に代えて行われる。なお、本実施形態に係る製造方法によって製造するカラーフィルタ基板は図3(a)及び(b)に符号“1”で示すカラーフィルタ基板とすることができる。また、カラーフィルタ基板1は、図1(b)に示すマザー基材12から切り出すことにより形成できる。

【0121】また、カラーフィルタ基板1に形成する色絵素の配列は図4に示すストライプ配列等のような各種配列とすることができる。また、カラーフィルタ基板1を形成するための工程は、図5に工程P1～P4で示す工程を採用できる。また、色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4において使用するインクジェット装置は図6に示す構造の装置を採用できる。

【0122】図14に示す実施形態が先の実施形態と異なる点は、図13と比較すれば明らかなように、インクジェットヘッド22をマザー基材12に対する初期位置すなわち主走査開始位置に置いたとき、キャリッジ25の全体が副走査方向Yに対して角度 θ で傾斜することにより、6個のノズル列28の延在方向Zが副走査方向Yに対して角度 θ で傾斜することである。

【0123】本実施形態の構成によれば、各ヘッド部20は副走査方向Yに対して角度 θ の傾斜状態でX方向へ主走査を行うので、各ヘッド部20に属する複数のノズル27のノズル間ピッチをマザー基材12上の色絵素形成領域の間隔及び保護膜形成領域の間隔、すなわちエレメント間ピッチに一致させることができる。このようにノズル間ピッチとエレメント間ピッチとを幾何学的に一致させれば、ノズル列28を副走査方向Yに関して位置制御する必要がなくなるので好都合である。

【0124】(第5実施形態)図15は本発明に係るカラーフィルタ基板の製造方法のさらに他の実施形態の主要工程を示しており、この工程も既に説明した先の実施形態における図13で示した工程に代えて行われる。なお、本実施形態に係る製造方法によって製造するカラーフィルタ基板は図3(a)及び(b)に符号“1”で示すカラーフィルタ基板とすることができる。また、カラーフィルタ基板1は、図1(b)に示すマザー基材12から切り出すことにより形成できる。

【0125】また、カラーフィルタ基板1に形成する色絵素の配列は図4に示すストライプ配列等のような各種配列とすることができる。また、カラーフィルタ基板1を形成するための工程は、図5に工程P1～P4で示す工程を採用できる。また、色絵素形成工程P3及び保護

24

膜形成工程P4において使用するインクジェット装置は図6に示す構造の装置を採用できる。

【0126】図15に示す実施形態が先の実施形態と異なる点は、図13と比較すれば明らかなように、インクジェットヘッド22をマザー基材12に対する初期位置すなわち主走査開始位置に置いたとき、キャリッジ25の全体は副走査方向Yに対して傾斜することはないが、6個のヘッド部20が個々に副走査方向Yに対して角度 θ で傾斜することにより、各ノズル列28の延在方向Zが副走査方向Yに対して角度 θ で傾斜することである。

【0127】本実施形態の構成によれば、各ノズル列28は副走査方向Yに対して角度 θ の傾斜状態でX方向へ主走査を行うので、各ノズル列28に属する複数のノズル27のノズル間ピッチをマザー基材12上の色絵素形成領域の間隔及び保護膜形成領域の間隔、すなわちエレメント間ピッチに一致させることができる。このようにノズル間ピッチとエレメント間ピッチとを幾何学的に一致させれば、ノズル列28を副走査方向Yに関して位置制御する必要がなくなるので好都合である。

【0128】また、本実施形態では図14のようにキャリッジ25の全体を傾斜させるのではなくて、個々のヘッド部20を傾斜させるようにしてあるので、吐出対象物であるマザー基材12に最も近いノズル27から最も遠いノズル27までの距離が図14の場合に比べて著しく小さくでき、それ故、X方向への主走査の時間を短縮化できる。これにより、カラーフィルタ基板の製造時間を短縮できる。

【0129】(第6実施形態)図16(a)は本発明に係るカラーフィルタ基板の他の実施形態を示している。また、図17(b)は図16(a)において矢印IVで示す部分を拡大して示している。また、図18(a)は図17(b)におけるV-V線に従った断面構造を示している。

【0130】ここに示すカラーフィルタ基板1は、図1(a)に示したカラーフィルタ基板1と同様に、大面積のマザー基材12内に設定された複数のカラーフィルタ形成領域11内に必要なパターンを形成した後に、個々のカラーフィルタ形成領域11を切断することによって形成される。

【0131】図1(a)に示した先の実施形態では、図3(a)に示したように、基材2上に形成されたバンク5によって区画された領域に各色絵素3R、3G、3Bをインクジェット法によって供給した。これに対し、図18(a)に示す本実施形態のカラーフィルタ基板1では、バンクは形成されず、各色絵素3R、3G、3Bが周知のパターニング法、例えばフォトリソグラフィ法によって互いに間隔を開けて所定の配列、例えば図4に示すような各種の配列に形成される。そして、上記の各色絵素3R、3G、3Bのパターニングの際に色絵素形成領域Sの外縁部に複数の隔壁15が同時にパターニン

(14)

25

グされる。

【0132】そしてその後、各色絵素3R、3G、3Bの間及び隔壁15同士の間に、例えば図17(a)に示すように、インクジェット法によって液滴状すなわちドット状の保護膜材料10を供給し、さらに焼成処理又は紫外線照射処理等を施す。これにより、図17(b)に示すように、各色絵素3R、3G、3Bの間及び隔壁15同士の間に保護膜4が形成される。

【0133】本実施形態の場合でも、色絵素形成領域Sの外縁部に隔壁15を設けたので、該色絵素形成領域Sの外縁部には保護膜4が、シール材形成領域Uに到達するまでに大きく広がることなく、緩やかなテーパー状に傾斜して形成される。従って、シール材のシール性が保護膜4によって損なわれたり、カラーフィルタ基板1の表面に形成される電極13が色絵素形成領域Sの外縁部分において切断したりすることを確実に防止できる。

【0134】図18(b)は図18(a)の実施形態の改変例を示している。図18(a)に示した実施形態では保護膜4の頂面と各色絵素3の頂面とが等しく設定されたが、図18(b)に示す実施形態では保護膜4の頂面が各色絵素3の頂面よりも高く、すなわち保護膜4が各色絵素3の全てを覆うようになっている。この場合には、保護膜4はスピコートによっても形成できる。

【0135】(第7実施形態)図19は本発明に係る液晶装置の一実施形態を示している。また、図20は図19におけるX-X線に従った液晶装置の断面構造を示している。なお、本実施形態の液晶装置は、単純マトリクス方式でフルカラー表示を行う半透過反射方式の液晶装置である。

【0136】図19において、液晶装置101は、液晶パネル102に半導体チップとしての液晶駆動用IC103a及び103bを実装し、配線接続要素としてのFPC(Flexible Printed Circuit)104を液晶パネル102に接続し、さらに液晶パネル102の裏面側に照明装置106をバックライトとして設けることによって形成される。

【0137】液晶パネル102は、第1基板107aと第2基板107bとをシール材108によって貼り合わせることによって形成される。シール材108は、例えば、スクリーン印刷等によってエポキシ系樹脂を第1基板107a又は第2基板107bの内側表面に環状に付着させることによって形成される。また、シール材108の内部には図20に示すように、導電性材料によって球状又は円筒状に形成された導通材109が分散状態で含まれる。

【0138】図20において、第1基板107aは透明なガラスや、透明なプラスチック等によって形成された板状の基材111aを有する。この基材111aの内側表面(図20の上側表面)には反射膜112が形成され、その上に絶縁膜113が積層され、その上に第1電

26

極114aが矢印D方向から見てストライプ状(図19参照)に形成され、さらにその上に配向膜116aが形成される。また、基材111aの外側表面(図20の下側表面)には偏光板117aが貼着等によって装着される。

【0139】図19では第1電極114aの配列を分かり易く示すために、それらのストライプ間隔を実際よりも大幅に広く描いており、よって、第1電極114aの本数が少なく描かれているが、実際には、第1電極114aはより多数本が基材111a上に形成される。

【0140】図20において、第2基板107bは透明なガラスや、透明なプラスチック等によって形成された板状の基材111bを有する。この基材111bの内側表面(図20の下側表面)にはカラーフィルタ118が形成され、その上に第2電極114bが上記第1電極114aと直交する方向へ矢印D方向から見てストライプ状(図19参照)に形成され、さらにその上に配向膜116bが形成される。また、基材111bの外側表面(図20の上側表面)には偏光板117bが貼着等によって装着される。

【0141】図19では、第2電極114bの配列を分かりやすく示すために、第1電極114aの場合と同様に、それらのストライプ間隔を実際よりも大幅に広く描いており、よって、第2電極114bの本数が少なく描かれているが、実際には、第2電極114bはより多数本が基材111b上に形成される。

【0142】図20において、第1基板107a、第2基板107b及びシール材108によって囲まれる間隙、いわゆるセルギャップ内には液晶、例えばSTN(SuperTwisted Nematic)液晶Lが封入されている。第1基板107a又は第2基板107bの内側表面には微小で球形のスペーサ119が多数分散され、これらのスペーサ119がセルギャップ内に存在することによりそのセルギャップの厚さが均一に維持される。

【0143】第1電極114aと第2電極114bは互いに直交関係に配置され、それらの交差点は図20の矢印D方向から見てドット・マトリクス状に配列する。そして、そのドット・マトリクス状の各交差点が1つの絵素ピクセルを構成する。カラーフィルタ118は、R(赤)、G(緑)、B(青)の各色要素を矢印D方向から見て所定のパターン、例えば、ストライプ配列、デルタ配列、モザイク配列等のパターンで配列させることによって形成されている。上記の1つの絵素ピクセルはそれらR、G、Bの各1つずつに対応しており、そしてR、G、Bの3色絵素ピクセルが1つのユニットになって1画素が構成される。

【0144】ドット・マトリクス状に配列される複数の絵素ピクセル、従って画素、を選択的に発光させることにより、液晶パネル102の第2基板107bの外側に文字、数字等といった像が表示される。このようにして

(15)

27

像が表示される領域が有効画素領域であり、図19及び図20において矢印Vによって示される平面的な矩形領域が有効表示領域となっている。

【0145】図20において、反射膜112はAPC合金、Al（アルミニウム）等といった光反射性材料によって形成され、第1電極114aと第2電極114bとの交差点である各絵素ピクセルに対応する位置に開口121が形成されている。結果的に、開口121は図20の矢印D方向から見て、絵素ピクセルと同じドット・マトリクス状に配列されている。

【0146】第1電極114a及び第2電極114bは、例えば、透明導電材であるITOによって形成される。また、配向膜116a及び116bは、ポリイミド系樹脂を一樣な厚さの膜状に付着させることによって形成される。これらの配向膜116a及び116bがラビング処理を受けることにより、第1基板107a及び第2基板107bの表面上における液晶分子の初期配向が決定される。

【0147】図19において、第1基板107aは第2基板107bよりも広い面積に形成されており、これらの基板をシール材108によって貼り合わせたとき、第1基板107aは第2基板107bの外側へ張り出す基板張出し部107cを有する。そして、この基板張出し部107cには、第1電極114aから延び出る引出し配線114c、シール材108の内部に存在する導通材109（図20参照）を介して第2基板107b上の第2電極114bと導通する引出し配線114d、液晶駆動用IC103aの入力用バンク、すなわち入力用端子に接続される金属配線114e、そして液晶駆動用IC103bの入力用バンクに接続される金属配線114f等といった各種の配線が適切なパターンで形成される。

【0148】本実施形態では、第1電極114aから延びる引出し配線114c及び第2電極114bに導通する引出し配線114dはそれらの電極と同じ材料であるITO、すなわち導電性酸化物によって形成される。また、液晶駆動用IC103a及び103bの入力側の配線である金属配線114e及び114fは電気抵抗値の低い金属材料、例えばAPC合金によって形成される。APC合金は、主としてAgを含み、付随してPd及びCuを含む合金、例えば、Ag98%、Pd1%、Cu1%から成る合金である。

【0149】液晶駆動用IC103a及び液晶駆動用IC103bは、ACF（Anisotropic Conductive Film：異方性導電膜）122によって基板張出し部107cの表面に接着されて実装される。すなわち、本実施形態では基板上に半導体チップが直接に実装される構造の、いわゆるCOG（Chip On Glass）方式の液晶パネルとして形成されている。このCOG方式の実装構造においては、ACF122の内部に含まれる導電粒子によって、液晶駆動用IC103a及び103bの入力側バ

28

ンクと金属配線114e及び114fとが導電接続され、液晶駆動用IC103a及び103bの出力側バンクと引出し配線114c及び114dとが導電接続される。

【0150】図19において、FPC104は、可撓性の樹脂フィルム123と、チップ部品124を含んで構成された回路126と、金属配線端子127とを有する。回路126は樹脂フィルム123の表面に半田付けその他の導電接続手法によって直接に搭載される。また、金属配線端子127はAPC合金、Cr、Cuその他の導電材料によって形成される。FPC104のうち金属配線端子127が形成された部分は、第1基板107aのうち金属配線114e及び金属配線114fが形成された部分にACF122によって接続される。そして、ACF122の内部に含まれる導電粒子の働きにより、基板側の金属配線114e及び114fとFPC側の金属配線端子127とが導通する。

【0151】FPC104の反対側の辺端部には外部接続端子131が形成され、この外部接続端子131が図示しない外部回路に接続される。そして、この外部回路から伝送される信号に基づいて液晶駆動用IC103a及び103bが駆動され、第1電極114a及び第2電極114bの一方に走査信号が供給され、他方にデータ信号が供給される。これにより、有効表示領域V内に配列されたドット・マトリクス状の絵素ピクセルが個々のピクセルごとに電圧制御され、その結果、液晶Lの配向が個々の絵素ピクセルごとに制御される。

【0152】図19において、いわゆるバックライトとして機能する照明装置106は、図20に示すように、アクリル樹脂等によって構成された導光体132と、その導光体132の光出射面132bに設けられた拡散シート133と、導光体132の光出射面132bの反対面に設けられた反射シート134と、発光源としてのLED（Light Emitting Diode）136とを有する。

【0153】LED136はLED基板137に支持され、そのLED基板137は、例えば導光体132と一体に形成された支持部（図示せず）に装着される。LED基板137が支持部の所定位置に装着されることにより、LED136が導光体132の側辺端面である光取込み面132aに対向する位置に置かれる。なお、符号138は液晶パネル102に加わる衝撃を緩衝するための緩衝材を示している。

【0154】LED136が発光すると、その光は光取込み面132aから取り込まれて導光体132の内部へ導かれ、反射シート134や導光体132の壁面で反射しながら伝播する間に光出射面132bから拡散シート133を通して外部へ平面光として出射する。

【0155】本実施形態の液晶装置101は以上のように構成されているので、太陽光、室内光等といった外部光が十分に明るい場合には、図20において、第2基板

(16)

29

107b側から外部光が液晶パネル102の内部へ取り込まれ、その光が液晶Lを通過した後に反射膜112で反射して再び液晶Lへ供給される。液晶Lはこれを挟持する電極114a及び114bによってR、G、Bの絵素ピクセルごとに配向制御されており、よって、液晶Lへ供給された光は絵素ピクセルごとに変調され、その変調によって偏光板117bを通過する光と、通過できない光とによって液晶パネル102の外部に文字、数字等といった像が表示される。これにより、反射型の表示が行われる。

【0156】他方、外部光の光量が十分に得られない場合には、LED136が発光して導光体132の光出射面132bから平面光が出射され、その光が反射膜112に形成された開口121を通して液晶Lへ供給される。このとき、反射型の表示と同様にして、供給された光が配向制御される液晶Lによって絵素ピクセルごとに変調され、これにより、外部へ像が表示される。これにより、透過型の表示が行われる。

【0157】上記構成の液晶装置101は、例えば、図21に示す製造方法によって製造される。この製造方法において、工程P1～工程P6の一連の工程が第1基板107aを形成する工程であり、工程P11～工程P14の一連の工程が第2基板107bを形成する工程である。第1基板形成工程と第2基板形成工程は、通常、それぞれが独自に行われる。

【0158】まず、第1基板形成工程について説明すれば、透光性ガラス、透光性プラスチック等によって形成された大面積のマザー基材の表面に液晶パネル102の複数個分の反射膜112をフォトリソグラフィ法等を用いて形成し、さらにその上に絶縁膜113を周知の成膜法を用いて形成し（工程P1）、次に、フォトリソグラフィ法等を用いて第1電極114a及び配線114c、114d、114e、114fを形成する（工程P2）。

【0159】次に、第1電極114aの上に塗布、印刷等によって配向膜116aを形成し（工程P3）、さらにその配向膜116aに対してラビング処理を施すことにより液晶の初期配向を決定する（工程P4）。次に、例えばスクリーン印刷等によってシール材108を環状に形成し（工程P5）、さらにその上に球状のスペーサ119を分散する（工程P6）。以上により、液晶パネル102の第1基板107a上のパネルパターンを複数個分有する大面積のマザー第1基板が形成される。

【0160】以上の第1基板形成工程とは別に、第2基板形成工程（図21の工程P11～工程P14）を実施する。まず、透光性ガラス、透光性プラスチック等によって形成された大面積のマザー基材を用意し、その表面に液晶パネル102の複数個分のカラーフィルタ118を形成する（工程P11）。このカラーフィルタの形成工程は図5に示した製造方法を用いて行われ、その製造

30

方法中の色絵素形成工程P3及び保護膜形成工程P4は図6のインクジェット装置16を用いて図13、図14、図15等にしたインクジェットヘッドの制御方法に従って実行される。これらカラーフィルタの製造方法及びインクジェットヘッドの制御方法は既に説明した内容と同じであるので、それらの説明は省略する。

【0161】図3（a）又は図3（b）に示すようにマザー基材12の上にブラックマスク6、バンク5、色絵素3及び保護膜4が形成されると、また、図18（a）又は図18（b）に示すようにマザー基材12の上にブラックマスク6、色絵素3及び保護膜4が形成されると、次に、フォトリソグラフィ法によって第2電極114bが形成され（工程P12）、さらに塗布、印刷等によって配向膜116bが形成され（工程P13）、さらにその配向膜116bに対してラビング処理が施されて液晶の初期配向が決められる（工程P14）。以上により、液晶パネル102の第2基板107b上のパネルパターンを複数個分有する大面積のマザー第2基板が形成される。

【0162】以上により大面積のマザー第1基板及びマザー第2基板が形成された後、それらのマザー基板をシール材108を間に挟んでアライメント、すなわち位置合わせした上で互いに貼り合わせる（工程P21）。これにより、液晶パネル複数個分のパネル部分を含んでいて未だ液晶が封入されていない状態の空のパネル構造体が形成される。

【0163】次に、完成した空のパネル構造体の所定位置にスクライブ溝、すなわち切断用溝を形成し、さらにそのスクライブ溝を基準にしてパネル構造体をブレイク、すなわち切断する（工程P22）。これにより、各液晶パネル部分のシール材108の液晶注入用開口110（図19参照）が外部へ露出する状態の、いわゆる短冊状の空のパネル構造体が形成される。

【0164】その後、露出した液晶注入用開口110を通して各液晶パネル部分の内部に液晶Lを注入し、さらに各液晶注入口110を樹脂等によって封止する（工程P23）。通常の液晶注入処理は、例えば、貯留容器の中に液晶を貯留し、その液晶が貯留された貯留容器と短冊状の空パネルをチャンバー等に入れ、そのチャンバー等を真空状態にしてからそのチャンバーの内部において液晶の中に短冊状の空パネルを浸漬し、その後、チャンバーを大気圧に開放することによって行われる。このとき、空パネルの内部は真空状態なので、大気圧によって加圧される液晶が液晶注入用開口を通してパネルの内部へ導入される。液晶注入後の液晶パネル構造体のまわりには液晶が付着するので、液晶注入処理後の短冊状パネルは工程24において洗浄処理を受ける。

【0165】その後、液晶注入及び洗浄が終わった後の短冊状のマザーパネルに対して再び所定位置にスクライブ溝を形成し、さらにそのスクライブ溝を基準にして短

(17)

31

冊状パネルを切断することにより、複数の液晶パネルが個々に切り出される(工程P25)。こうして作製された個々の液晶パネル102に対して図19に示すように、液晶駆動用IC103a、103bを実装し、照明装置106をバックライトとして装着し、さらにFPC104を接続することにより、目標とする液晶装置101が完成する(工程P26)。

【0166】以上のように本実施形態に係る液晶装置に関しては、特にカラーフィルタ基板118、111bにおいて、図3(a)、図3(b)、図18(a)及び図18(b)に示したように、複数の色絵素3の間やそれらの上に供給された保護膜4の材料は複数の隔壁15同士の間にも入り込む。このとき、隔壁15は保護膜4の材料が色絵素3の形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜4はその外縁が色絵素形成領域Sの外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜4がシール材108の下に入り込んでシール材108のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【0167】(その他の実施形態)以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変できる。

【0168】例えば、以上の説明では色絵素としてR、G、Bを用いたが、R、G、Bに限定されることはなく、例えばC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)を採用してもかまわない。その場合にあっては、R、G、Bの色絵素材料に代えて、C、M、Yの色を有する色絵素材料を用いれば良い。

【0169】また、以上に説明した実施形態では、図8等に示すようにインクジェットヘッド22の中に6個のヘッド部20を設けたが、ヘッド部20の数はより少なく又はより多くすることができる。

【0170】また、図1(b)に示した実施形態では、マザー基材12の中に複数列のカラーフィルタ形成領域11が設定される場合を例示したが、マザー基材12の中に1列のカラーフィルタ形成領域11が設定される場合にも本発明を適用できる。また、マザー基材12とはほぼ同じ大きさの又はそれよりもかなり小さい1個のカラーフィルタ形成領域11だけがそのマザー基材12の中に設定される場合にも本発明を適用できる。

【0171】また、図6及び図7に示したインクジェット装置16では、インクジェットヘッド22をX方向へ移動させて基材12を主走査し、基材12を副走査駆動装置21によってY方向へ移動させることによりインクジェットヘッド22によって基材12を副走査することにしたが、これとは逆に、基材12のY方向への移動によって主走査を実行し、インクジェットヘッド22のX方向への移動によって副走査を実行することもできる。

32

【0172】また、上記実施形態では、圧電素子の焼み変形を利用してインクを吐出する構造のインクジェットヘッドを用いたが、他の任意の構造のインクジェットヘッドを用いることもできる。

【0173】また、図1に示す実施形態では図1(a)に示す通り、色絵素3の1つごとに隔壁15を1つずつ形成したが、隔壁15は色絵素3の2つごと、3つごと、あるいはそれ以上の数ごとに1つずつ形成することもできる。また、電極配線が通過しない辺に形成される隔壁に関しては色絵素3の位置とは無関係に隔壁15を形成することもできる。

【0174】

【発明の効果】本発明に係るカラーフィルタ基板及びその製造方法並びに液晶装置によれば、複数の色絵素の間やそれらの上に供給された保護膜は前記複数の隔壁同士の間にも入り込む。このとき、隔壁は保護膜が色絵素形成領域の外側へ広く流れ出ることを防止し、これにより、保護膜はその外縁が色絵素形成領域の外縁に対してばらつくことなく均一な距離だけ離れた所に止まるように形成される。この結果、例えば、保護膜がシール材の下に入り込んでシール材のシール性が劣化する等といった不都合を回避できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明に係るカラーフィルタ基板の一実施形態の平面図を示し、(b)はそのカラーフィルタ基板の基礎となるマザー基板の平面図を示している。

【図2】図1(a)における矢印II部分の拡大平面図である。

【図3】図2(b)におけるIII-III線に従った断面図である。

【図4】カラーフィルタ基板の表面に形成される複数種類の色絵素の配列形態の例を示す図である。

【図5】本発明に係るカラーフィルタ基板の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図6】図5に示す製造方法の一工程で用いられるインクジェット装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図7】図6の装置の主要部を拡大して示す斜視図である。

【図8】図7の装置で用いられるインクジェットヘッドの一実施形態及びそのインクジェットヘッドに用いられるヘッド部の一実施形態を示す斜視図である。

【図9】インクジェットヘッドのヘッド部の改変例を示す斜視図である。

【図10】インクジェットヘッドのヘッド部の内部構造を示す図であって、(a)は一部破断斜視図を示し、(b)は(a)のJ-J線に従った断面構造を示す。

【図11】図6のインクジェット装置に用いられる電気制御系を示すブロック図である。

【図12】図11の制御系によって実行される制御の流れを示すフローチャートである。

(18)

33

【図13】本発明に係るカラーフィルタの製造方法の一実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図14】本発明に係るカラーフィルタの製造方法の他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図15】本発明に係るカラーフィルタの製造方法のさらに他の実施形態の主要工程を模式的に示す平面図である。

【図16】(a)は本発明に係るカラーフィルタ基板の他の実施形態の平面図を示し、(b)はそのカラーフィルタ基板の基礎となるマザー基板の平面図を示してい

る。

【図17】図16(a)における矢印IV部分の拡大平面図である。

【図18】図17(b)におけるV-V線に従った断面図である。

【図19】本発明に係る液晶装置の一実施形態を分解状態で示す斜視図である。

【図20】図19におけるX-X線に従って液晶装置の断面構造を示す断面図である。

【図21】図19に示す液晶装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図22】従来のカラーフィルタ基板の一例を示す図である。

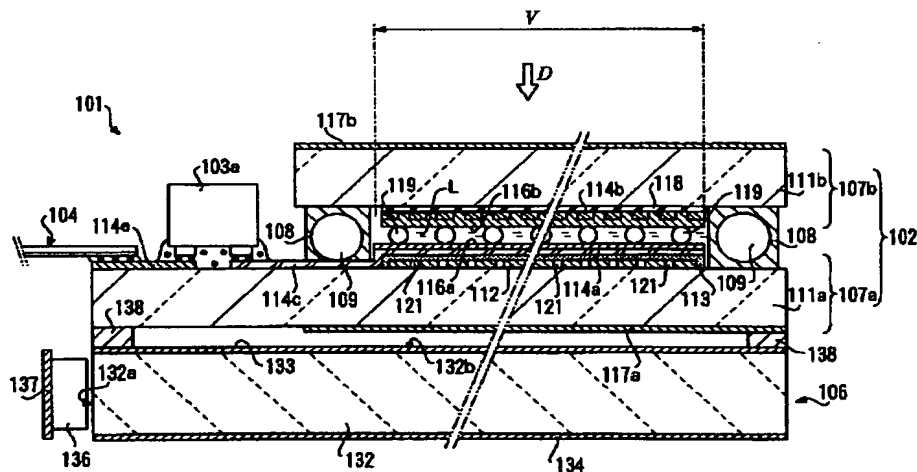
【符号の説明】

1	カラーフィルタ基板
2	基材
3	色絵素
4	保護膜
5	バンク (区画材)
6	ブラックマスク
7	色絵素形成領域
8	色絵素材料
10	保護膜材料

34

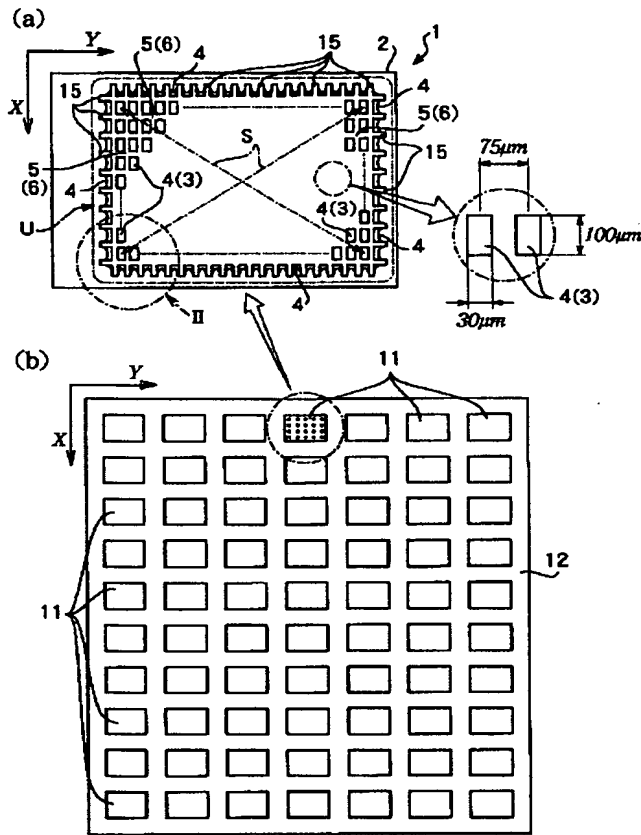
11	カラーフィルタ形成領域
12	マザー基材
15	隔壁
16	インクジェット装置
17	ヘッド位置制御装置
18	基板位置制御装置
19	主走査駆動装置
20	ヘッド部
21	副走査駆動装置
22	インクジェットヘッド
25	キャリッジ
26	ヘッドユニット
27	ノズル
28	ノズル列
39	インク加圧体
41	圧電素子
49	テーブル
81	ヘッド用カメラ
82	基板用カメラ
101	液晶装置
102	液晶パネル
107a, 107b	基板
111a, 111b	基材
114a, 114b	電極
118	カラーフィルタ
L	液晶
M	色絵素材料、保護膜材料
S	色絵素形成領域
T	テーパ形状
30	U シール材形成領域
W	段差部
X	主走査方向
Y	副走査方向

【図20】

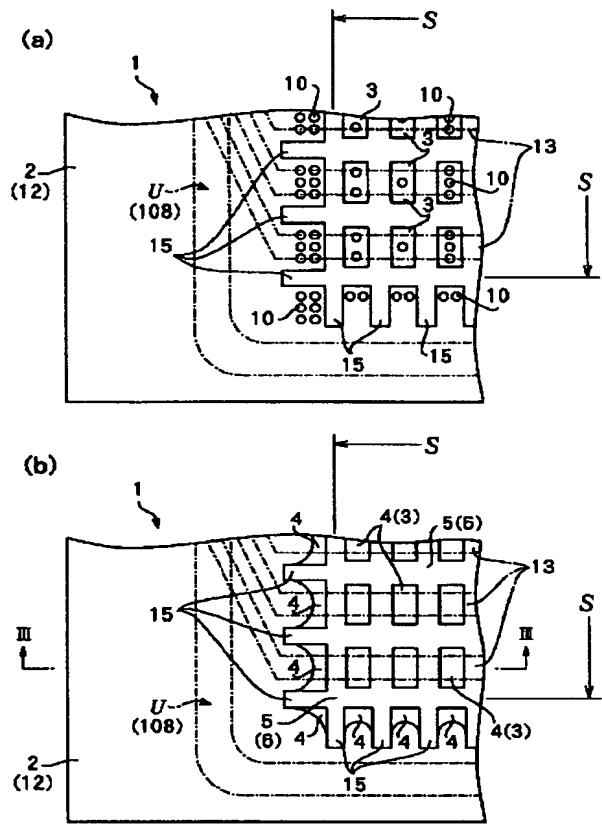


(19)

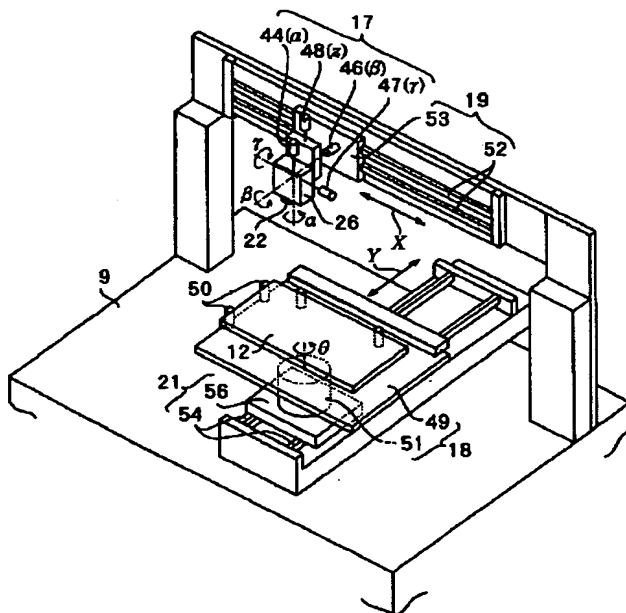
【図 1】



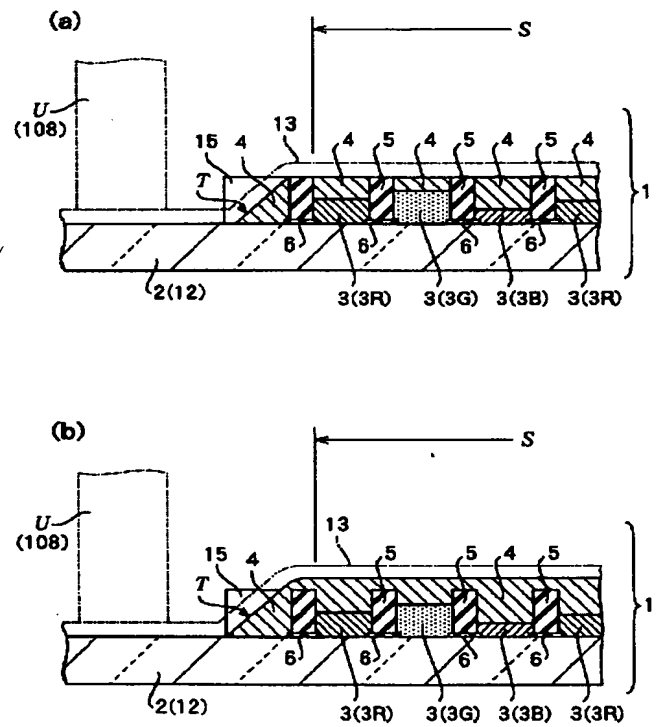
【図 2】



【図 7】

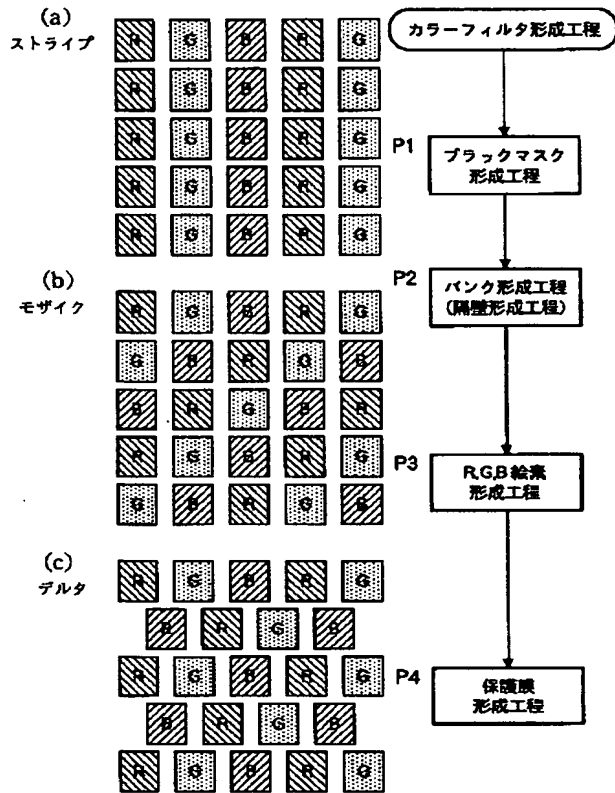


【図 3】

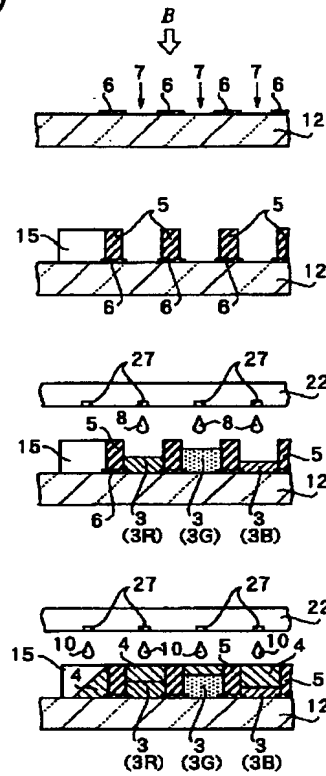


(20)

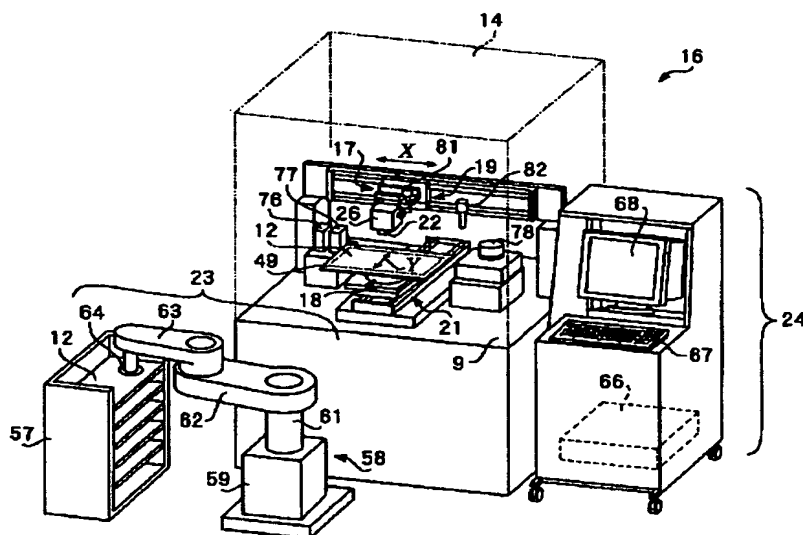
【図 4】



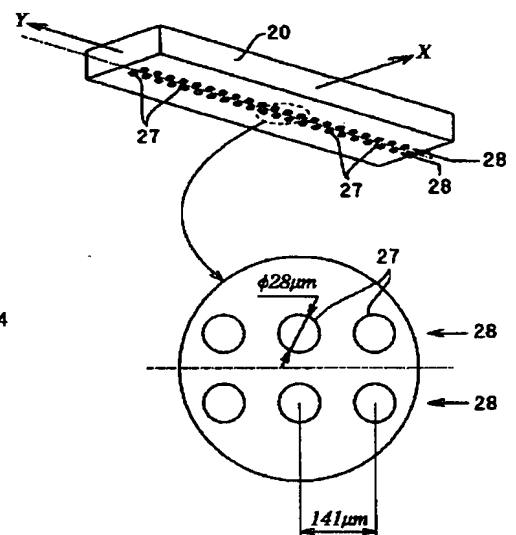
【図 5】



【図 6】

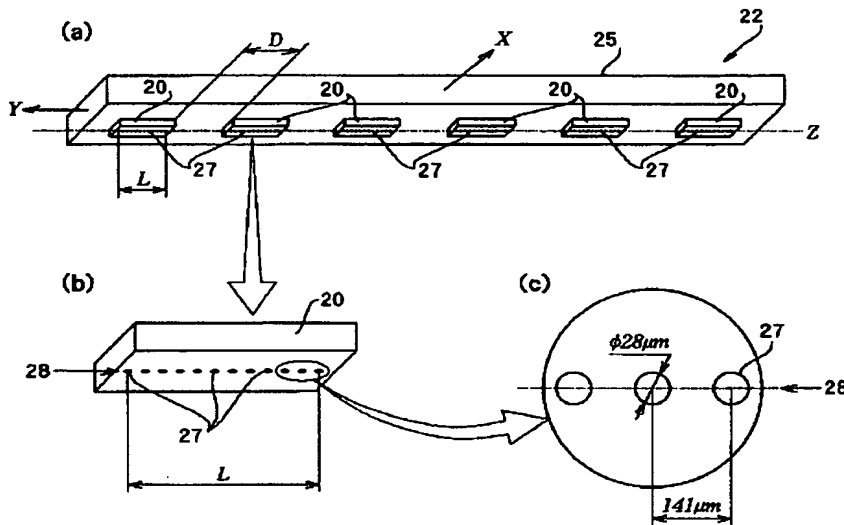


【图 9】

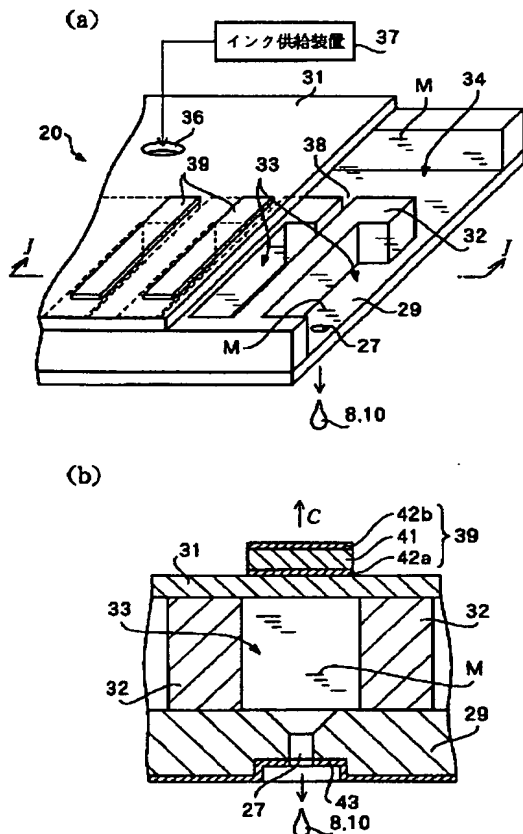


(21)

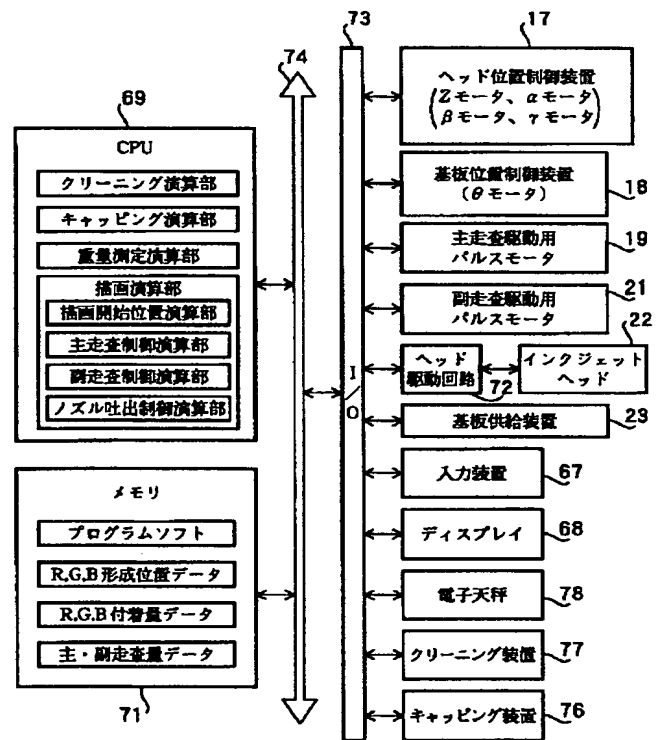
【図8】



【図10】

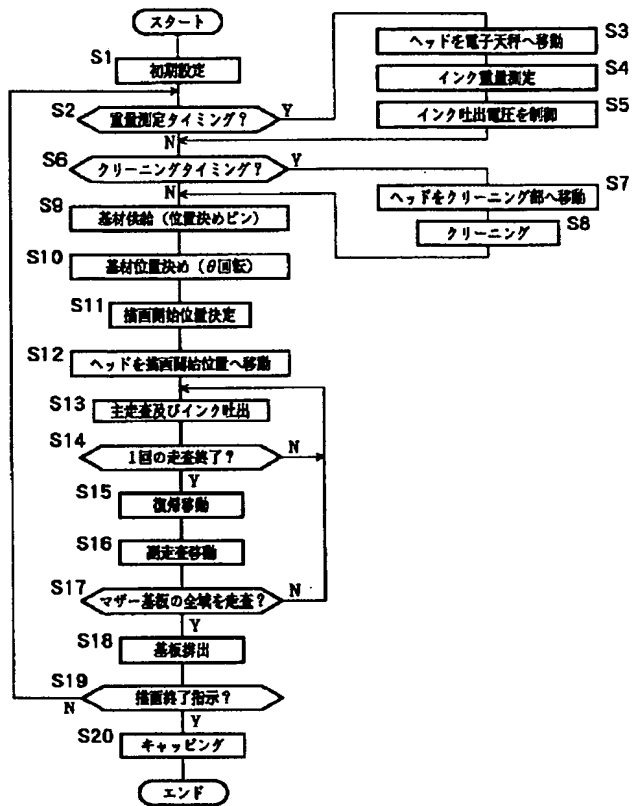


【図11】

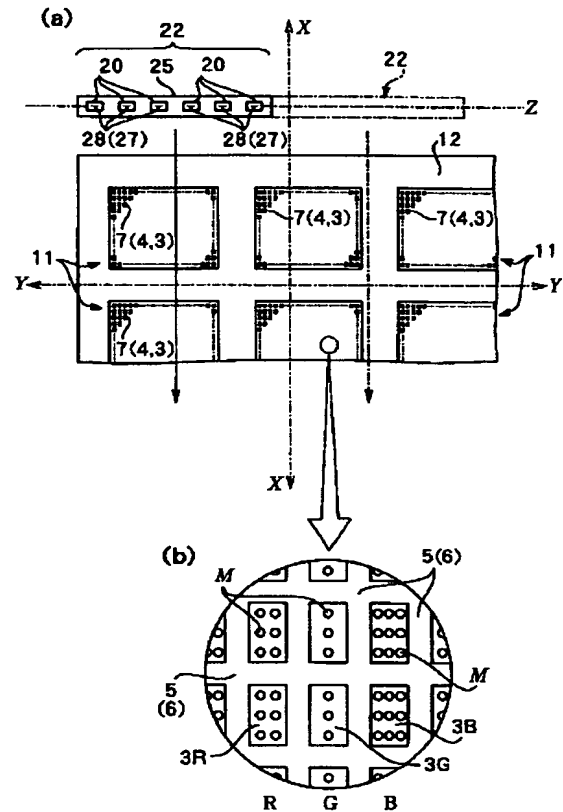


(22)

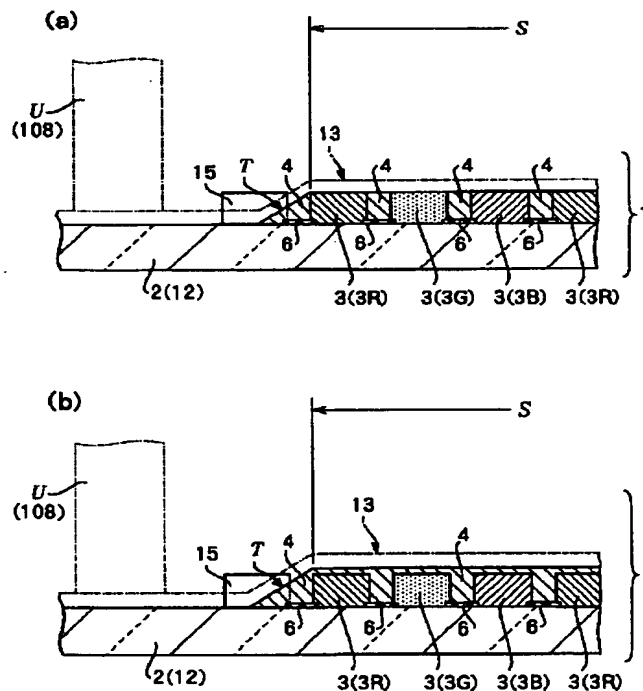
【図12】



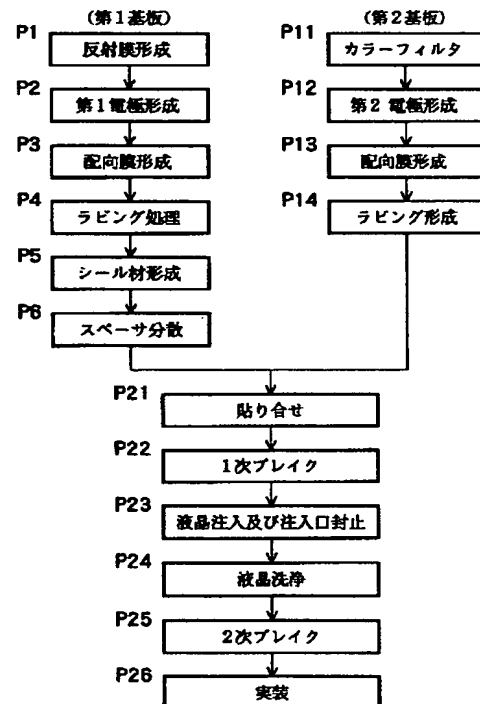
【図13】



【図18】

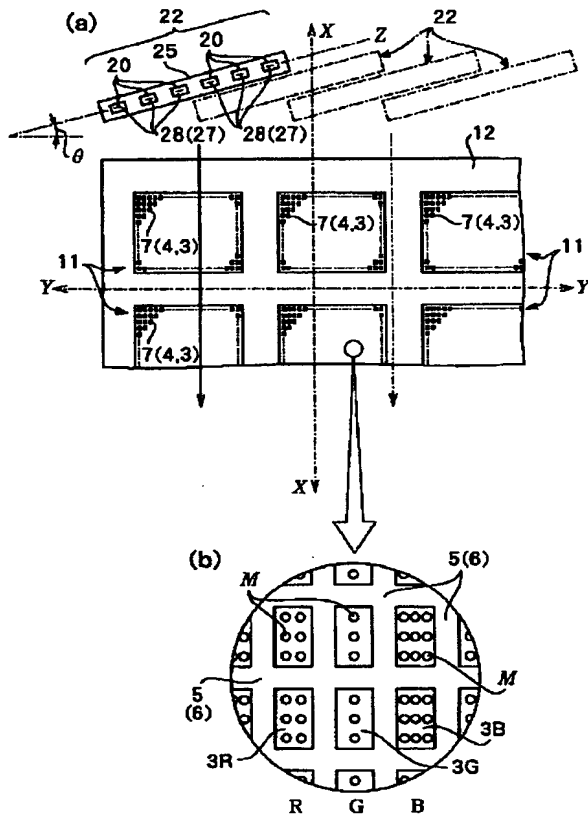


【図21】

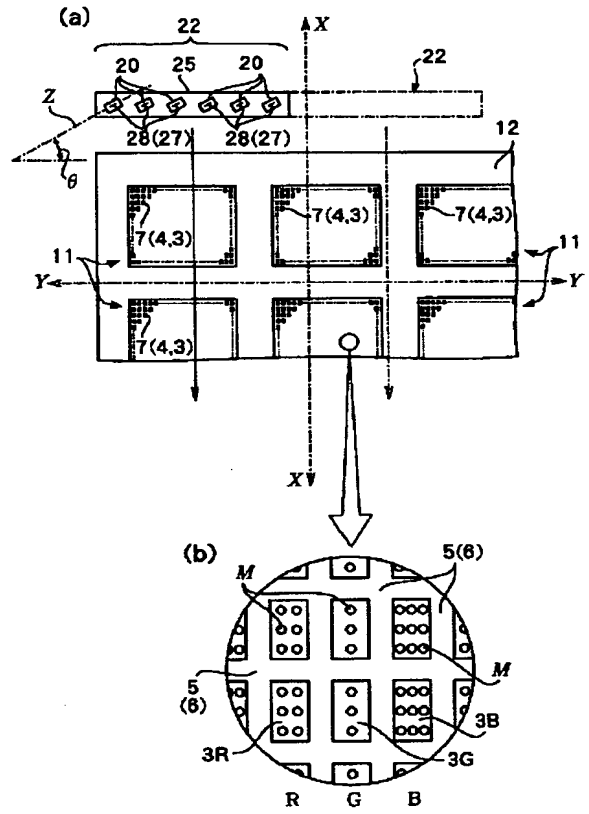


(23)

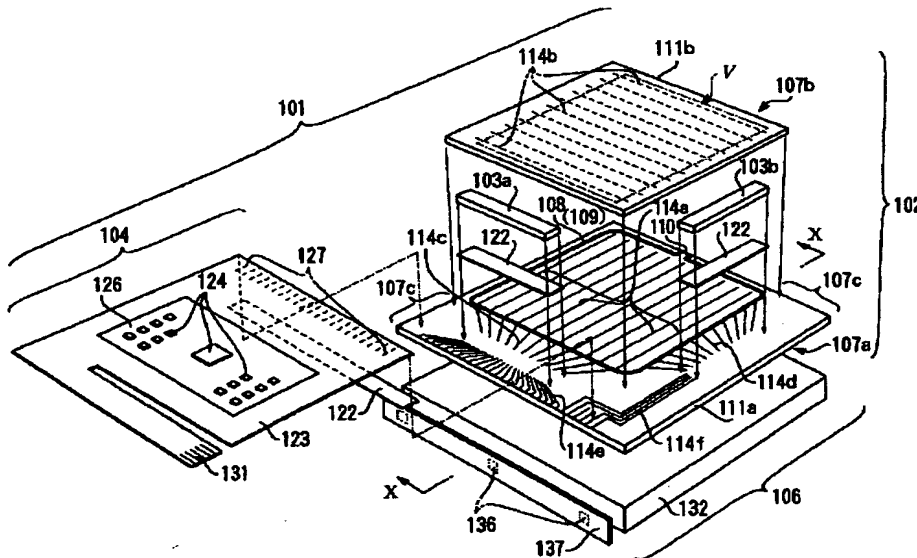
【図 14】



【図 15】

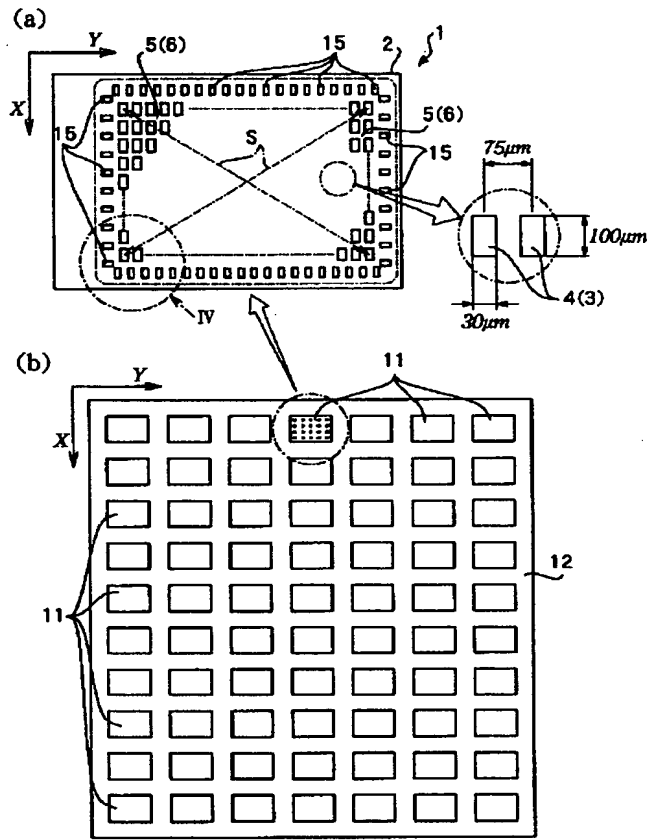


【図 19】

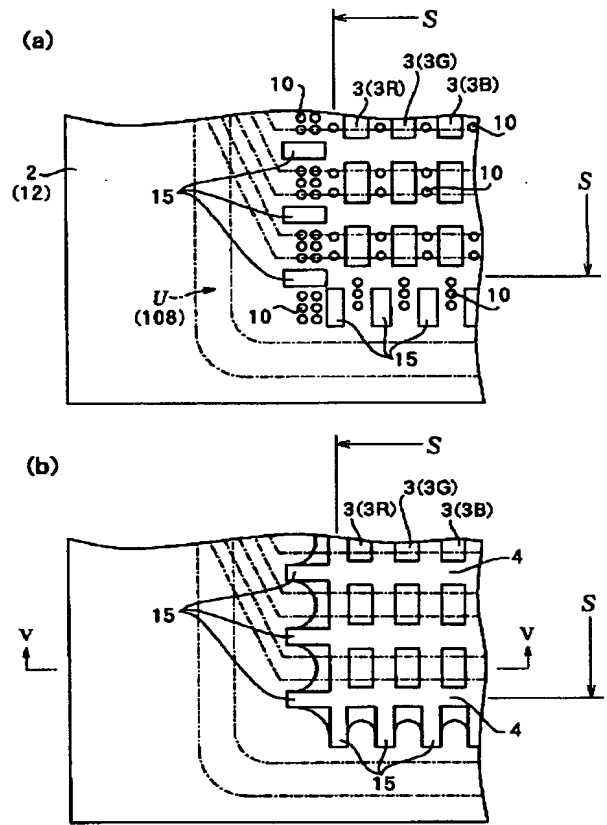


(24)

【図16】

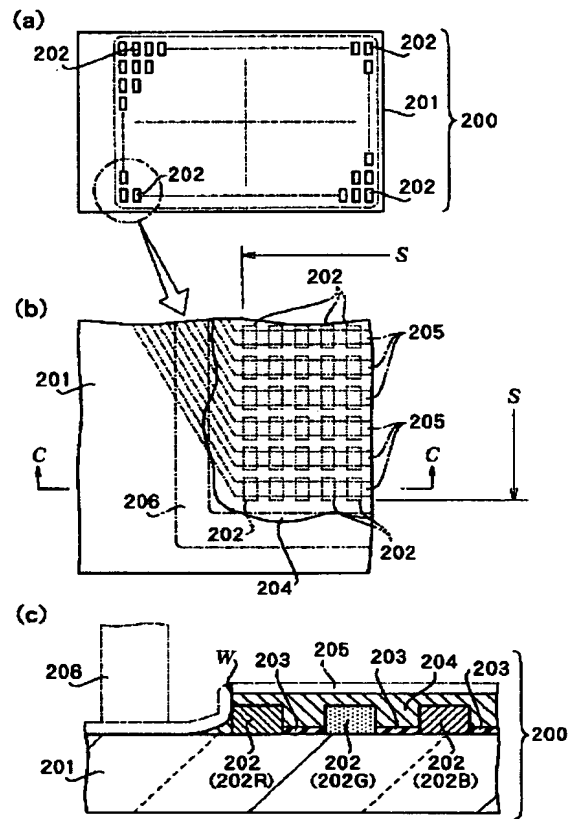


【図17】



(25)

【図22】



フロントページの続き

(72) 発明者 伊藤 達也
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
ーエプソン株式会社内

(72) 発明者 川瀬 智己
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
ーエプソン株式会社内

Fターム(参考) 2H048 BA64 BB02 BB06 BB07 BB12
BB23 BB37 BB43
2H091 FA02Y GA01 GA16
5C094 AA31 BA43 CA19 CA24 DA13
EA04 EA07 EB02 ED03 ED20
GB10

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-196124

(43)Date of publication of application : 10.07.2002

(51)Int.Cl.

G02B 5/20
G02F 1/1335
G09F 9/30

(21)Application number : 2000-390417

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 22.12.2000

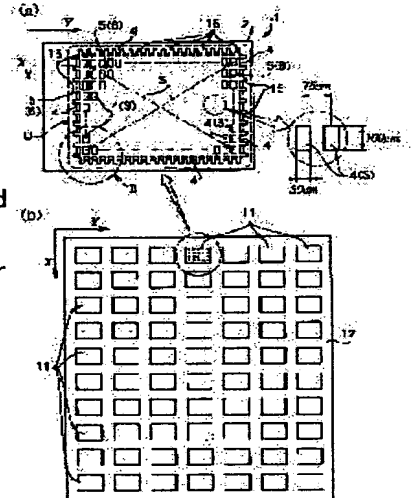
(72)Inventor : ARIGA HISASHI
KATAUE SATORU
ITO TATSUYA
KAWASE TOMOKI

(54) COLOR FILTER SUBSTRATE, METHOD FOR MANUFACTURING COLOR FILTER AND LIQUID CRYSTAL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent irregular and widening bleeding of a protective film to the outside of a pixel-forming region, on the base surface of a color filter substrate.

SOLUTION: The color filter substrate has a base material 2, a plurality of pixels 3 formed on the surface of the base material 2, a plurality of barrier walls 15 formed on the surface of the base material 2 and present on the outermost edge of the pixels 3 but extending farther to the outside, and a protective film 4 formed either among the plurality of pixels 3 or on the pixels or both of them. In the peripheral edge of the pixel forming region S, the protective film 4 is prevented from flowing out and bleeding to the outside by the effect of the barrier walls 15.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The color filter substrate characterized by having a base material, two or more color picture elements formed in the front face of this base material, two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formed in either or both between said two or more color picture elements and on them.

[Claim 2] The color-filter substrate characterized by to have a base material, the partition material which is formed in the front face of this base material, and divides this base material to two or more fields, two or more color picture elements formed in said two or more fields, two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formed on two or more of said color picture elements.

[Claim 3] It is the color filter substrate characterized by there being said septum inside a sealant formation field in claim 1 or claim 2.

[Claim 4] It is the color filter substrate characterized by the thing of claim 1 to claim 3 for which said septum is formed in fields other than an electrode wiring formation field in any one at least.

[Claim 5] It is the color filter substrate characterized by the thing of claim 1 to claim 4 established for said septum for said every color picture element in any one at least.

[Claim 6] It is the color filter substrate by which it is forming [in / at least / any one / said septum]- with same ingredient as said color picture element or said partition material characterized [of claim 1 to claim 4].

[Claim 7] The manufacture approach of the color filter substrate characterized by having the color picture element formation process which forms two or more color picture elements on a base material, the septum formation process which forms two or more septa on said base material so that it may begin to extend outside in a pan although it is in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formation process which forms a protective coat after said septum formation process at either or both between said two or more color picture elements and on them.

[Claim 8] The partition material formation process which forms the partition material which divides the front face of a base material to two or more fields on this base material, The color picture element formation process which forms a color picture element in said two or more fields, and the septum formation process which forms two or more septa on said base material so that it may begin to extend outside in a pan although it is in the outermost edge of those color picture elements, The manufacture approach of the color filter substrate characterized by having the protective coat formation process which forms a protective coat on said two or more color picture elements after said septum formation process.

[Claim 9] It is the manufacture approach of the color filter substrate characterized by forming said septum inside a sealant formation field with said septum formation process in claim 7 or claim 8.

[Claim 10] It is the manufacture approach of the color filter substrate characterized by the thing of claim 7 to claim 9 for which said septum is formed in fields other than an electrode wiring formation field

with said septum formation process in any one at least.

[Claim 11] It is the manufacture approach of the color filter substrate characterized by the thing of claim 7 to claim 10 for which said septum is formed for said every color picture element with said septum formation process in any one at least.

[Claim 12] claim 7 to claim 11 -- at least -- any one -- setting -- said septum formation process -- said color picture element formation process -- simultaneously -- or the manufacture approach of the color filter substrate characterized by said partition material formation process, simultaneously being carried out.

[Claim 13] It is the manufacture approach of the color filter substrate characterized [in / at least / any one] by said protective coat being [of claim 7 to claim 12] a liquid.

[Claim 14] In the liquid crystal equipment which has the substrate of the pair which pinches liquid crystal, and the color filter substrate formed in one [at least] substrate said color filter substrate A base material, two or more color picture elements formed in the front face of this base material, and two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, Liquid crystal equipment characterized by having the protective coat formed in either or both between said two or more color picture elements and on them.

[Claim 15] In the liquid crystal equipment which has the substrate of the pair which pinches liquid crystal, and the color filter substrate formed in one [at least] substrate said color filter substrate A base material and the partition material which is formed in the front face of this base material, and divides this base material to two or more fields, Liquid crystal equipment characterized by having two or more color picture elements formed in said two or more fields, two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formed on said two or more color picture elements.

[Claim 16] It is liquid crystal equipment characterized by there being said septum inside a sealant formation field in claim 14 or claim 15.

[Claim 17] It is liquid crystal equipment characterized by the thing of claim 14 to claim 16 for which said septum is formed in fields other than an electrode wiring formation field in any one at least.

[Claim 18] It is liquid crystal equipment characterized by the thing of claim 14 to claim 17 established for said septum for said every color picture element in any one at least.

[Claim 19] It is liquid crystal equipment by which it is forming [in / at least / any one / said septum]- with same ingredient as said color picture element or said partition material characterized [of claim 14 to claim 18].

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the color filter substrate which forms two or more color picture elements called R, G, B, C, M, Y, etc. on a base material, and changes, and its manufacture approach. Moreover, this invention relates to the liquid crystal equipment constituted using the color filter substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, liquid crystal equipment is widely used for electronic equipment, such as a portable telephone and a pocket mold personal computer, increasingly. Moreover, the liquid crystal equipment of the structure of performing color display using a color filter substrate has also come to be used widely.

[0003] As a color filter substrate, what forms each color picture element 202 of R (red), G (green), and B (blue) in a predetermined array, for example, a stripe array, a mosaic array, a delta array, etc., and grows into the front face of the base material 201 formed by glass, plastics, etc. is known so that it may be shown in the former (a), for example, drawing 22. About the color picture element 202, as shown, for example in drawing 22 (c), R color picture element 202R, G color picture element 202G, and B color picture element 202B adjoin each other mutually, and are formed. And the black mask 203 is formed between each color picture element 202, and a protective coat 204 is further formed of a spin coat etc. on the color picture element 202. In addition, illustration of a protective coat 24 is omitted in drawing 22 (a).

[0004] Some reasons for forming a protective coat 204 are considered. In case an electrode is formed in the front face of the color filter substrate by 1st carrying out flattening of the front face of a color filter substrate by formation of a protective coat, it is for preventing that the electrode goes out. It is for raising the contrast ratio between pixels by low resistance-ization of the electrode on a protective coat to the 2nd. It is for preventing that the pixel in a color filter substrate gets damaged in the process performed to the 3rd following the protective coat formation back, i.e., a protection feature. When a color filter substrate is used for liquid crystal equipment, after liquid crystal is enclosed with the 4th into a cel gap, it is for preventing that an impurity is spread from a color filter substrate to liquid crystal.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the conventional color filter substrate 200, as shown in drawing 22 (b), there was a problem that a protective coat 204 flowed and spread to the long distance of the outside of the formation field S of the color picture element 202. Moreover, there was also a problem that a steep level difference was formed in a protective coat 204 in the place of the color picture element 202 of the outermost edge as Sign W shows to drawing 22 (c).

[0006] Here, considering the case where the color filter substrate 200 is used as a component of liquid crystal equipment, a transparent electrode 205 is formed in the front face of the color filter substrate 200 of ITO (Indium Tin Oxide) etc. so that it may pass through each color picture element 202 top, and the sealant 206 for sticking an opposite substrate on the color filter substrate 200 further forms or pastes up around the color filter substrate 200.

[0007] When the protective coat 204 spread widely to the outside of the formation field S of the color picture element 202 as mentioned above in the conventional color filter substrate 200, the protective coat 204 entered down to the sealant 206, and there was a possibility that the trouble of peeling of a sealant 206 etc. might arise. Moreover, when the level difference steep to the rim of a protective coat 204 as mentioned above occurred, there was a possibility that the electrode 205 formed on a protective coat 204 might cut in the level difference part.

[0008] This invention is accomplished in view of the above-mentioned trouble, and aims at preventing

that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely and disorderly in the base material front face of a color filter substrate.

[0009]

[Means for Solving the Problem] (1) In order to attain the above-mentioned purpose, the 1st color filter substrate concerning this invention A base material, two or more color picture elements formed in the front face of this base material, and two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, It is characterized by having the protective coat formed in either or both between said two or more color picture elements and on them.

[0010] According to this 1st color filter substrate, the protective coat supplied between two or more color picture elements and on them enters also among said two or more septa. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[0011] (2) Next, the 2nd color filter substrate concerning this invention A base material and the partition material which is formed in the front face of this base material, and divides this base material to two or more fields, It is characterized by having two or more color picture elements formed in said two or more fields, two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formed on said two or more color picture elements.

[0012] The point that this 2nd color filter substrate differs from the 1st previous color filter substrate is that partition material is formed on the surface of a base material, and a color picture element is formed in two or more fields divided by this partition material. According to this 2nd color filter substrate, since partition material exists among two or more color picture elements, a protective coat is not formed between color picture elements, and a protective coat is formed on a color picture element.

[0013] According to this 2nd color filter substrate, the protective coat supplied on two or more color picture elements enters also among said two or more septa. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[0014] As for said septum, in the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable that it is inside a sealant formation field. here -- or a sealant is after this a member for forming the seal field by which intervened among those substrates, stuck those substrates, and the closure was carried out from the outside among those substrates, i.e., a cel gap, when forming for example, liquid crystal equipment by sticking this color filter substrate on other one substrate. If it is made to make a septum exist inside a sealant formation field as mentioned above, it can prevent certainly that a protective coat enters to the sealant bottom.

[0015] Moreover, as for said septum, in the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable to be formed in fields other than an electrode wiring formation field. here -- or an electrode is after this an electrode for being in the effective viewing area of liquid crystal equipment, and impressing an electrical potential difference to liquid crystal when forming for example, liquid crystal equipment by sticking this color filter substrate on other one substrate. Moreover, electrode wiring is a wiring part which is connected with the above-mentioned electrode, is prolonged to the outside of the effective viewing area of the above-mentioned liquid crystal equipment, and comes out to it. If a septum will be formed in fields other than an electrode wiring formation field as mentioned above, since electrode wiring will pass along

the part where a level difference is loose, an open circuit of electrode wiring can be prevented certainly. [0016] Moreover, as for said septum, in the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable to be prepared for said every color picture element. That is, as for a septum, it is desirable to form for every number beyond every every every ** 2three and it of a color picture element.

[0017] Moreover, as for said septum, in the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable to be formed with the same ingredient as said color picture element or said partition material. According to this configuration, a septum can also be formed in a color picture element and coincidence, or can also be formed in partition material and coincidence.

[0018] (3) Next, the manufacture approach of the 1st color filter substrate concerning this invention The color picture element formation process which forms two or more color picture elements on a base material, and the septum formation process which forms two or more septa on said base material so that it may begin to extend outside in a pan although it is in the outermost edge of those color picture elements, It is characterized by having the protective coat formation process which forms a protective coat after said septum formation process at either or both between said two or more color picture elements and on them.

[0019] According to the manufacture approach of this 1st color filter substrate, the protective coat supplied between two or more color picture elements and on them in the protective coat formation process enters also among said two or more septa formed in the septum formation process. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[0020] (4) Next, the manufacture approach of the 2nd color filter substrate concerning this invention The partition material formation process which forms the partition material which divides the front face of a base material to two or more fields on this base material, The color picture element formation process which forms a color picture element in said two or more fields, and the septum formation process which forms two or more septa on said base material so that it may begin to extend outside in a pan although it is in the outermost edge of those color picture elements, It is characterized by having the protective coat formation process which forms a protective coat on said two or more color picture elements after said septum formation process.

[0021] The point that the manufacture approach of this 2nd color filter substrate differs from the manufacture approach of the 1st previous color filter substrate is forming partition material on the surface of a base material in a partition material formation process, and forming a color picture element in two or more fields divided by partition material in the color picture element formation process. According to this 2nd color filter substrate, since partition material exists among two or more color picture elements, a protective coat is not formed between color picture elements, and a protective coat is formed on a color picture element.

[0022] According to the manufacture approach of this 2nd color filter substrate, the protective coat supplied on two or more color picture elements in the protective coat formation process enters also among said two or more septa formed in the septum formation process. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[0023] As for said septum, in the manufacture approach of the above 1st or the 2nd color filter substrate, being formed inside a sealant formation field is desirable in said septum formation process. If it carries out like this, it can prevent certainly that a protective coat enters to the sealant bottom.

[0024] Moreover, as for said septum, in the manufacture approach of the above 1st or the 2nd color filter substrate, it is desirable in said septum formation process to be formed in fields other than an electrode wiring formation field. If it carries out like this, since electrode wiring will pass along the part where a level difference is loose, an open circuit of electrode wiring can be prevented certainly.

[0025] Moreover, as for said septum, in the manufacture approach of the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable in said septum formation process to be formed for said every color picture element. That is, as for a septum, it is desirable to form for every number beyond every every every ** 2three and it of a color picture element.

[0026] Moreover, as for said septum formation process, in the manufacture approach of the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable to be carried out to said partition material formation process and coincidence simultaneous in said color picture element formation process. In order to form a septum, it becomes unnecessary thereby, to establish a special process.

[0027] Moreover, as for said protective coat, in the manufacture approach of the above 1st and the 2nd color filter substrate, it is desirable that it is a liquid. Usually, a protective coat can be formed by acrylic resin, the epoxy resin, imide system resin, or fluororesin. It is desirable to form a protective coat with the ink jet method, a spin coat method, etc. in this invention, and, as for a protective coat, for this reason, it is desirable that it is a liquid.

[0028] (5) Next, the 1st liquid crystal equipment concerning this invention In the liquid crystal equipment which has the substrate of the pair which pinches liquid crystal, and the color filter substrate formed in one [at least] substrate said color filter substrate A base material, two or more color picture elements formed in the front face of this base material, and two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, It is desirable to have the protective coat formed in either or both between said two or more color picture elements and on them.

[0029] According to this 1st liquid crystal equipment, in the color filter substrate which is that component, the protective coat supplied between two or more color picture elements and on them enters also among said two or more septa. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.]. Consequently, the display quality by liquid crystal equipment is highly maintainable over a long period of time.

[0030] (6) Next, the 2nd liquid crystal equipment concerning this invention In the liquid crystal equipment which has the substrate of the pair which pinches liquid crystal, and the color filter substrate formed in one [at least] substrate said color filter substrate A base material and the partition material which is formed in the front face of this base material, and divides this base material to two or more fields, It is characterized by having two or more color picture elements formed in said two or more fields, two or more septa formed in the front face of said base material so that it might begin to have extended outside in a pan although it was in the outermost edge of those color picture elements, and the protective coat formed on said two or more color picture elements.

[0031] The point that this 2nd liquid crystal equipment differs from the 1st previous liquid crystal equipment is that partition material is formed on the surface of a base material, and a color picture element is formed in two or more fields divided by this partition material in a color filter substrate. According to this 2nd liquid crystal equipment, in a color filter substrate, since partition material exists among two or more color picture elements, a protective coat is not formed between color picture elements, and a protective coat is formed on a color picture element.

[0032] According to this 2nd liquid crystal equipment, in a color filter substrate, the protective coat supplied on two or more color picture elements enters also among said two or more septa. At this time,

a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.]. Consequently, the display quality by liquid crystal equipment is highly maintainable over a long period of time.

[0033] As for said septum, in the above 1st or the 2nd liquid crystal equipment, it is desirable that it is inside a sealant formation field. If it carries out like this, it can prevent certainly that a protective coat enters to the sealant bottom.

[0034] Moreover, as for said septum, in the above 1st or the 2nd liquid crystal equipment, it is desirable to be formed in fields other than an electrode wiring formation field. If it carries out like this, since electrode wiring will pass along the part where a level difference is loose, an open circuit of electrode wiring can be prevented certainly.

[0035] Moreover, as for said septum, in the above 1st or the 2nd liquid crystal equipment, it is desirable to be prepared for said every color picture element. That is, as for a septum, it is desirable to form for every number beyond every every every ** 2three and it of a color picture element.

[0036] Moreover, as for said septum, in the above 1st or the 2nd liquid crystal equipment, it is desirable to be formed with the same ingredient as said color picture element or said partition material. According to this configuration, a septum can also be formed in a color picture element and coincidence, or can also be formed in partition material and coincidence.

[0037]

[Embodiment of the Invention] (The 1st operation gestalt) Drawing 1 (a) shows the planar structure of 1 operation gestalt of the color filter substrate concerning this invention. Moreover, drawing 2 (b) expands and shows the part shown by the arrow head II in drawing 1 (a). Moreover, drawing 3 (a) shows the cross-section structure according to the III-III line in drawing 2 (b).

[0038] As the color filter substrate 1 of this operation gestalt is shown in drawing 3 R> 3 (a) The base material 2 formed by glass, plastics, etc., and the black mask 6 formed in the front face of the base material 2, It has the bank 5 as partition material formed on the black mask 6, two or more color picture elements 3 formed in the field surrounded by the bank 5, and the protective coat 4 which is the field similarly surrounded by bank 5 and was formed in piles on the color picture element 3.

[0039] Bank 5 and its lower layer black mask 6 are formed in the shape of [which uses as a grid hole the part which forms the color picture element 3 and a protective coat 4 in drawing 1 (a)] a grid, and a protective coat 4 and its lower layer color picture element 3 are formed so that those grid holes may be filled. Thereby, two or more color picture elements 3 are formed in the front face of a base material 2 in the shape of a dot matrix with the shape of a dot pattern, and this operation gestalt.

[0040] The black mask 6 is formed with a resin ingredient without translucency. Bank 5 is formed of either of resin with resin without translucency, or translucency, when forming the black mask 6 separately. Moreover, when forming bank 5 with resin without translucency, the function of a black mask can also be made to serve a double purpose by the bank 5.

[0041] Two or more color picture elements 3 are formed of the color material of any 1 color of R (red), G (green), and the B (blue), respectively, and each of those color picture elements 3 are put in order by the predetermined array. drawing 3 (a) -- by 3R, 3G show G color picture element, and 3B shows B color picture element for R color picture element, respectively.

[0042] As an array of each color picture elements 3R, 3G, and 3B, the stripe array shown in drawing 4 (a), the mosaic array shown in drawing 4 (b), the delta array shown in drawing 4 (c) are known, for example. A stripe array is a color scheme in which all the columns of a matrix become the same color. A mosaic array is a color scheme in which three color picture elements of the arbitration located in a line on the straight line in every direction become three colors of R, G, and B. And a delta array is a color scheme in which three color picture elements to which arrangement of a color picture element is carried

out in a completely different class, and which arbitration adjoins become three colors of R, G, and B.

[0043] In drawing 1 (a), for example, the diagonal dimension of the magnitude of the color filter substrate 1 is 1.8 inches. Moreover, the magnitude of one color picture element 3 is 30micrometerx100micrometer. Moreover, spacing between each color picture element 3 and the pitch between the so-called elements are 75 micrometers.

[0044] With this operation gestalt, as shown in drawing 3 (a), the height, i.e., the thickness, of each color picture elements 3R, 3G, and 3B, it is formed more thinly than bank 5 and each thickness differs further, respectively. Specifically G color picture element 3G are the thickest, R color picture element 3R is thick to the degree, and B color picture element 3B is formed most thinly. Thus, thickness differs between each color picture element for emphasizing or weakening a specific color as main according to an observer's hope. Moreover, thickness control of forming lower than other color picture elements G color picture element 3G with large effect in resolution visually etc. may be performed.

[0045] Moreover, about the protective coat 4 formed in piles on the color picture element 3, the thickness of the protective coat 4 corresponding to G color picture element 3G is the thinnest, the protective coat 4 corresponding to R color picture element 3R is thin to the degree, and the protective coat 4 corresponding to B color picture element 3B is formed most thickly. And the height of the top face of the protective coat 4 formed in each color picture element 3 in piles is almost equal to the height of bank 5 by such thickness control.

[0046] It is semantics also including the difference in such height that the height of a protective coat 4 and bank 5 includes physically the case of being the same, completely with "it being almost equal" in this case, when those height is slightly different for the error on manufacture, or unescapable reasons of manufacture from the first and a protective coat 4 can act similarly functionally.

[0047] In addition, the height is almost equal to the height of bank 5, and the protective coat 4 does not necessarily need to be formed. Even in this case, a protective coat 4 can attain functions, such as a protection feature which prevents damage on the color picture element 3, and diffusion prevention of the impurity to liquid crystal.

[0048] With this operation gestalt, although it is in the outermost edge of two or more color picture elements 3 as shown in drawing 1 (a), two or more septa 15 are formed in the front face of a base material 2 so that it may begin to extend outside in a pan. Moreover, these septa 15 are formed so that it may stop at the inside field of the field (henceforth a sealant formation field) U which the field or sealant in which a sealant is formed pastes up. With this operation gestalt, as shown in drawing 3 (a) and drawing 2 (b), the septum 15 is formed with the same ingredient as bank 5 so that it may extend and appear from bank 5 in one that is,. In case patterning of the bank 5 is carried out, patterning is carried out to coincidence and, specifically, it is formed in it.

[0049] Moreover, in addition to being formed in piles on each color picture element 3, a protective coat 4 is formed also between the adjacent septa 15. The protective coat 4 between such septa 15 is supplied between septa 15 at the time of the spin coat processing, when using a spin coat method and forming a protective coat 4 on each color picture element 3. On the other hand, in using the ink jet method and forming a protective coat 4 on each color picture element 3, the protective coat 4 between each septum 15 aims at between those septa 15, and it forms ink, i.e., a protective coat ingredient, the specified quantity and by carrying out the regurgitation as a dot-like ink droplet.

[0050] As shown in drawing 2 (b), it originates in the surface tension between septa 15 etc., and an outflow outside is regulated, and without presenting the breadth of a disorderly rim which goes in the direction of an outside which was seen by the conventional protective coat shown in drawing 22 (b) with the sign 204, the protective coat 4 formed with the protective coat ingredient supplied between each septum 15 will be comparatively small, and will present a homogeneous broadening.

[0051] For this reason, it is cancelable un-arranging [of it being lost that rim spreading and flowing of the protection material 4 to the sealant formation field U, and a protective coat 4 flowing into the lower layer of the sealant 108 therefore formed in U, such as a sealant formation field, and, for example,

degrading the seal nature of a sealant 108 when while constitutes liquid crystal equipment and this color filter substrate 1 is used as a substrate etc.].

[0052] Considering the case where the color filter substrate 1 of this operation gestalt is used as a color filter substrate for example, in liquid crystal equipment, in drawing 3 (a), an electrode 13 is formed in the front face of the color picture element 3. At this time, if irregularity is shown in the front face of the color filter substrate 1 in which the color picture element 3 was formed, a level difference will be made to an electrode, and there is a possibility that that electrode may be disconnected. On the other hand, according to the color filter substrate 1 of this operation gestalt with which the front face was smoothly formed by forming a protective coat 4, cutting of such an electrode can be prevented certainly.

[0053] Moreover, when there are those septa 15, the protective coat 4 formed with the protective coat ingredient supplied between septa 15 does not form a level difference steeply in the place of the color picture element 202 which is in the outermost edge like [in the case of the conventional protective coat shown with the sign 204 in drawing 22 (c)], but as Sign T shows to drawing 3 (a), it is formed in the shape of [loose] a taper.

[0054] For this reason, for example, when while constitutes liquid crystal equipment and this color filter substrate 1 is used as a substrate, it can avoid that the wiring part of the electrode 13 formed in the front face of the color filter substrate 1 bends with big curvature in the rim section of the color picture element formation field S, therefore cutting of an electrode can be prevented certainly.

[0055] In addition, although the septum 15 was formed for every ** of the color picture element 3 also about any of a lengthwise direction (the direction of X), and a longitudinal direction (the direction of Y) with the operation gestalt shown in drawing 1 (a), it may replace with this and you may form for every number beyond every two and it of the color picture element 3. Moreover, in drawing 2 (b), an electrode 13 is wiring, and those septa 15 are formed in fields other than the field in which wiring prolonged from an electrode 13 is formed about the septum 15 in a left part side the side pulled out on the outside of the sealant formation field U by drawing 2 (b). That is, and two or more septa 15 will be formed in the location for which electrode wiring is avoided and which sandwiches electrode wiring if it puts in another way. Moreover, in drawing 2 (b), the electrode 13 of the location which forms those septa 15 about the septum 15 in a lower side side is unrelated the side in which electrode wiring is not formed.

[0056] In using the color filter substrate 1 concerning this operation gestalt which consists of the above configurations as an optical element for a full color display, it performs a full color display by forming one pixel for R, G, and the B3 piece color picture element 3 as one unit, and making any one or those combination of R, G, and B in 1 pixel pass light alternatively. At this time, the black mask 6 formed with the resin ingredient without translucency prevents that light leaks from parts other than color picture element 3.

[0057] The color filter substrate 1 shown in drawing 3 (a) is cut down from the mother base material 12 of a large area as shown in drawing 1 (b). Each color filter substrate 1 is formed by specifically forming the pattern for one piece of the color filter substrate 1 in each front face of two or more color filter formation fields 11 set up in the mother base material 12 first, forming the slot for cutting in the surroundings of those color filter formation fields 11 further, and cutting the mother base material 12 along those slots further.

[0058] The manufacture approach of manufacturing hereafter the color filter substrate 1 shown in drawing 1 (a), and its manufacturing installation are explained.

[0059] Drawing 5 shows the manufacture approach of the color filter substrate 1 typically in order of the process. First, the black mask 6 is seen from arrow-head B, and it forms in a grid-like pattern with the resin ingredient which does not have translucency in the front face of the mother base material 12 formed by glass, plastics, etc., for example, Cr, (chromium). The part 7 of the grid hole of a grid-like pattern is the field in which the color picture element 3 is formed, i.e., a color picture element formation field. The flat-surface dimension at the time of seeing from [of each color picture element formation field 7 formed with this black mask 6] arrow-head B is formed in about 30micrometerx100micrometer.

[0060] After the black mask 6 forms an ingredient, for example, Cr etc., by the membrane formation technique of arbitration, for example, sputtering, uniformly by the uniform thickness of about 0.1–0.2 micrometers, it is formed in a grid-like pattern by the proper patterning technique, for example, the photolithography method, (process P1). In a process P2, bank 5 is formed after formation of the black mask 6. The resin of ** ink nature is specifically desirably formed in predetermined thickness using a spin coat method, and it forms in the shape of [predetermined] a grid using the still more proper patterning technique, for example, the photolithography method. Two or more septa 15 of each other are opened and formed in it and coincidence for spacing at the rim section of the color picture element formation field S in the case of this bank formation.

[0061] Then, in a process P3, in each field divided by the bank 5, the ink jet method is used and the color picture element 3 of R, G, and B is formed. Scanning the front face of the mother base material 12 by the ink jet head 22, it breathes out as an ink droplet to the predetermined timing corresponding to the array pattern which shows either of drawing 4 the color picture element ingredient 8 from the nozzle 27 prepared in the ink jet head 22, and is made to specifically adhere on the mother base material 12. And a color picture element ingredient is solidified by baking processing or UV irradiation processing, and the color picture element 3 is formed. The color picture element pattern of the array of hope is formed by repeating this processing to each color picture elements 3R and 3G and every 3B.

[0062] Then, in a process P4, it is in each field divided by the bank 5, and on the color picture element 3, the ink jet method is used and a protective coat 4 is formed. Like the case of the color picture element 3, scanning the front face of the mother base material 12 by the ink jet head 22, as the predetermined timing corresponding to the array pattern shown in either of drawing 4 shows the protective coat ingredient 10 to drawing 2 (a) from the nozzle 27 prepared in the ink jet head 22, it breathes out as an ink droplet 10 and, specifically, supplies on each color picture element 3 on the mother base material 12. At this time, the protective coat ingredient 10 is supplied also among two or more septa 15.

[0063] And as a protective coat ingredient is solidified by after that, for example, 200 degrees C, and baking processing for 30 minutes – 60 minutes and it is shown in drawing 2 (b), a protective coat 4 is formed. In addition, a septum 15 begins to be prolonged and die length and height are appropriately set up according to the physical properties of the ingredient of a protective coat 4, for example, viscosity, surface tension, etc.

[0064] By supplying the protective coat ingredient 10 of the specified quantity in the shape of an ink dot also among two or more septa 15, the protective coat 4 which spreads while becoming low the shape of a taper gently is formed in the rim section of the color picture element formation field S in the condition that the rim does not spread greatly.

[0065] In addition, in the ink jet processing in the color picture element formation process P3, the scan of the ink jet head 22 is repeated for R [of the color picture element 3], G, and B each color of every, a color picture element is formed, or the nozzle of R, G, and B3 color is furnished to one ink jet head 22, and R, G, and B3 color can also be formed in coincidence by one scan.

[0066] On the other hand, in the ink jet processing in the protective coat formation process P4, the ink droplet of the specified quantity is supplied throughout [scan term / 1 time of the ink jet head 22 of] throughout [scan term / of plurality] depending on the case to two or more grid-like holes of all formed of bank 5. However, when the thickness of the color picture element 3 currently formed in the grid-like hole differs for every color of R, G, and B, the discharge quantity of the ink which carries out the regurgitation from a nozzle 27 is also adjusted in optimum dose for every color.

[0067] You may decide to exchange and equip the same ink jet equipment with the ink jet head 22 used with the color picture element formation process P3, and the ink jet head 22 used with the protective coat formation process P4, or may decide to equip separate ink jet equipment with each, and to use those ink jet equipments according to an individual. Moreover, the thing same as ink jet equipment which equips with the ink jet head 22 and it depending on the case is used, and the approach that the ink supplied to the same ink jet head 22 is exchanged between a color picture element ingredient and a

protective coat ingredient can also be adopted.

[0068] in addition, the scan method of the mother base material 12 by the ink jet head 22 in the color picture element formation process P3 and the protective coat formation process P4 is not limited to a special approach, and is considered by versatility. For example, arrange two or more nozzles 27 in the almost same die length as one side of the mother base material 12, and a nozzle train is constituted. The approach of supplying the picture element ingredient 8 and the protective coat ingredient 10 all over the mother base material 12 by one scan, How to supply ink all over the mother base material 12 etc. can be considered by repeating vertical scanning for shifting horizontal scanning and the horizontal-scanning location for carrying out the regurgitation of the ink about the ink jet head 22 which has the nozzle train of the die length of the mother base material 12 shorter than one side, and performing it.

[0069] Drawing 6 shows 1 operation gestalt of the ink jet equipment which is an example of the equipment for carrying out the color picture element formation process P3 and the protective coat formation process P4 of drawing 5. This ink jet equipment 16 is equipment for making a color picture element ingredient or a protective coat ingredient breathe out and adhere to the predetermined location in each color filter formation field 11 in the mother base material 12 (to refer to drawing 1 (b)) as a drop of ink.

[0070] The head unit 26 which ink jet equipment 16 equipped with the ink jet head 22 in drawing 6, The head positional controller 17 which controls the location of the ink jet head 22, The substrate positional controller 18 which controls the location of the mother base material 12, and the horizontal-scanning driving gear 19 which carries out horizontal-scanning migration of the ink jet head 22 to the mother base material 12, The vertical-scanning driving gear 21 which carries out vertical-scanning migration of the ink jet head 22 to the mother base material 12, It has the control apparatus 24 which manages whole control of the substrate feeder 23 which supplies the mother base material 12 to the predetermined activity location in ink jet equipment 16, and ink jet equipment 16.

[0071] Each equipment of the head positional controller 17, the substrate positional controller 18, the horizontal-scanning driving gear 19, and the vertical-scanning driving gear 21 is installed on the base 9. Moreover, each of those equipments are covered with covering 14 if needed.

[0072] The ink jet head 22 has the six head sections 20 and the carriage 25 as a support means which puts in order and supports those head sections 20 with plurality and this operation gestalt, as shown in drawing 8 (a). Carriage 25 has in the location which should support the head section 20, somewhat larger hole, i.e., crevice, than the head section 20, it is put into each head section 20 into those holes, and it is further fixed by the conclusion means of a screw, adhesives, and others. Moreover, the head section 20 may be fixed by mere press fit, without using a special conclusion means, when the location of the head section 20 to carriage 25 is decided correctly.

[0073] The head section 20 has the nozzle train 28 formed by arranging two or more nozzles 27 in seriate, as shown in drawing 8 (b). The number of nozzles 27 is 180, the bore diameter of a nozzle 27 is 28 micrometers, and the nozzle pitch between nozzles 27 is 141 micrometers. In drawing 1 (a) and drawing 1 (b), the main scanning direction to a base material 2 and the mother base material 12 is the direction of X, the direction of Y which intersects perpendicularly with it is the direction of vertical scanning, and those directions of X and the direction of Y are set up as illustration to the ink jet head 22 in drawing 8 (a).

[0074] Although the ink jet head 22 carries out horizontal scanning of the mother base material 12 by carrying out a parallel displacement in the direction of X, a color picture element ingredient or a protective coat ingredient is made to adhere to the predetermined location in the mother base material 12 by carrying out the regurgitation of the color picture element ingredient or protective coat ingredient as ink alternatively between this horizontal scanning from two or more nozzles 27 in each head section 20. Moreover, the ink jet head 22 can shift the horizontal-scanning location by the ink jet head 22 at the predetermined spacing by carrying out parallel translation only of die-length [for one train] L of the predetermined distance 28, for example, a nozzle train, or its integral multiple in the direction Y of

vertical scanning.

[0075] When each head section 20 is attached in carriage 25, the nozzle train 28 of each head section 20 is set up so that it may appear in a straight line Z. moreover, the spacing D of each adjacent head section 20 is set up so that the distance between nozzle 27 of the endmost part location of the head section 20 of an adjacent pair which is alike, respectively and belongs may become equal to die-length L of the nozzle train 28 in each head section 20. Such arrangement about the nozzle train 28 is a measure for simplifying horizontal-scanning control of the direction of X about the ink jet head 22, and vertical-scanning control about the direction of Y, and the arrangement gestalt of the nozzle train 28, i.e., the array gestalt over the carriage 25 of the head section 20, can be set as arbitration in addition to the above.

[0076] Each head section 20 has the internal structure shown in drawing 10 (a) and drawing 10 (b). Specifically, the head section 20 has two or more batch members 32 which join them to the nozzle plate 29 made from stainless steel, and the diaphragm 31 which counters it mutually. Between a nozzle plate 29 and a diaphragm 31, two or more ink rooms 33 and ***** 34 are formed of the batch member 32. Two or more ink rooms 33 and ***** 34 are mutually open for free passage through a path 38.

[0077] The ink supply hole 36 is formed in the proper place of a diaphragm 31, and the ink feeder 37 is connected to this ink supply hole 36. This ink feeder 37 supplies the color picture element ingredient M or the protective coat ingredient M to the ink supply hole 36. It is [ingredient / M / the supplied color picture element ingredient M or / protective coat] full of ***** 34, and further full of the ink room 33 through a path 38. [ingredient] About the color picture element ingredient M, it is any 1 color of R, G, and B which is supplied from the ink feeder 37, and the head section 20 which is different to each color, respectively is prepared.

[0078] In addition, the color picture element ingredient M is formed by making a solvent distribute each color color material of R, G, and B. Moreover, the protective coat ingredient M is the heat-curing mold resin or photo-curing mold resin which has translucency, for example, can be formed including at least one of acrylic resin, an epoxy resin, imide system resin, or the fluororesin. Moreover, the viscosity of the protective coat ingredient M is desirably set as 10cps – 50cps. This is because it becomes difficult in less than 10cps to carry out the regurgitation of the constant rate from a nozzle 27 in exceeding that it becomes difficult for a fluidity to be too high and to form in a specific configuration, and 50cps.

[0079] The nozzle 27 for injecting the color picture element ingredient M or the protective coat ingredient M in the shape of jet from the ink room 33 is formed in the nozzle plate 29. Moreover, the rear face of the field which forms the ink room 33 of a diaphragm 31 is made to correspond to this ink room 33, and the ink pressurization object 39 is attached in it. This ink pressurization object 39 has the electrodes 42a and 42b of the pair which pinches this in piezoelectric-device 41 list, as shown in drawing 10 (b). It bends and a piezoelectric device 41 deforms so that it may project by energization to Electrodes 42a and 42b to the outside shown by the arrow head C, and thereby, the volume of the ink room 33 increases. Then, the color picture element ingredient M equivalent to a part for the volume which increased, or the protective coat ingredient M flows into the ink room 33 through a path 38 from ***** 34.

[0080] Next, if the energization to a piezoelectric device 41 is canceled, both this piezoelectric device 41 and the diaphragm 31 will return to the original configuration. Thereby, since the ink room 33 also returns to the original volume, the pressure of the color picture element ingredient M in the interior of the ink room 33 or the protective coat ingredient M rises, and from a nozzle 27, towards the mother base material 12 (refer to drawing 1 (b)), the color picture element ingredient M or the protective coat ingredient M serves as drops 8 and 10, and it spouts. In addition, the ** ink layer 43 which consists of nickel-tetrafluoroethylene eutectoid deposit in order to prevent the flight deflection of drops 8 and 10, hole plugging of a nozzle 27, etc. is formed in the periphery of a nozzle 27.

[0081] In drawing 7, the head positional controller 17 has the Z motor 48 to which the parallel displacement of the alpha motor 44 to which the field internal version of the ink jet head 22 is carried

out, the beta motor 46 which carries out rocking rotation of the ink jet head 22 at the circumference of an axis parallel to the direction Y of vertical scanning, the gamma motor 47 which carries out rocking rotation of the ink jet head 22 at the circumference of an axis parallel to a main scanning direction X, and the ink jet head 22 is carried out in the vertical direction.

[0082] The substrate positional controller 18 shown in drawing 6 has the table 49 which carries the mother base material 12, and the theta motor 51 to which the field internal version of the table 49 is carried out like an arrow head theta in drawing 7 R> 7. Moreover, the horizontal-scanning driving gear 19 shown in drawing 6 has the guide rail 52 prolonged to a main scanning direction X, and the slider 53 which built in the linear motor by which a pulse drive is carried out, as shown in drawing 7 . When the linear motor to build in operates, along with a guide rail 52, the parallel displacement of the slider 53 is carried out to a main scanning direction.

[0083] Moreover, the vertical-scanning driving gear 21 shown in drawing 6 has the guide rail 54 prolonged in the direction Y of vertical scanning, and the slider 56 which built in the linear motor by which a pulse drive is carried out, as shown in drawing 7 . When the linear motor to build in operates, along with a guide rail 54, the parallel displacement of the slider 56 is carried out in the direction Y of vertical scanning.

[0084] The linear motor by which a pulse drive is carried out into a slider 53 or a slider 56 can control the location on the main scanning direction X of the ink jet head 22 which could perform angle-of-rotation control of an output shaft minutely by the pulse signal supplied to this motor, therefore was supported by the slider 53, the location on the direction Y of vertical scanning of a table 49, etc. with high definition. In addition, the position control of the ink jet head 22 or a table 49 is not restricted to the position control which used the pulse motor, but can also be realized by the feedback control using a servo motor, and the control approach of other arbitration.

[0085] The substrate feeder 23 shown in drawing 6 has the substrate hold section 57 which holds the mother base material 12, and the robot 58 which conveys the mother base material 12. A robot 58 has the pedestal 59 put on installation sides, such as a floor and the ground, the rise-and-fall shaft 61 which carries out rise-and-fall migration to a pedestal 59, the 1st arm 62 which rotates the rise-and-fall shaft 61 as a core, the 2nd arm 63 rotated to the 1st arm 62, and the adsorption pad 64 prepared in the tip inferior surface of tongue of the 2nd arm 63. The adsorption pad 64 can adsorb the mother base material 12 by air suction etc.

[0086] In drawing 6 , by the horizontal-scanning driving gear 19, it drives, and it is under the locus of the ink jet head 22 which carries out horizontal-scanning migration, and capping equipment 76 and cleaning equipment 77 are arranged in one near location of the vertical-scanning driving gear 21. Moreover, the electronic balance 78 is arranged in the near location of another side. Cleaning equipment 77 is equipment for washing the ink jet head 22. The electronic balance 78 is a device which measures the weight of the drop of the ink breathed out from each nozzle 27 in the ink jet head 22 for every nozzle. And capping equipment 76 is equipment for preventing desiccation of a nozzle 27, when the ink jet head 22 is in a standby condition.

[0087] Near the ink jet head 22, the camera 81 for heads is arranged by the relation which moves to the ink jet head 22 and one. Moreover, the camera 82 for substrates supported by the means for supporting (not shown) formed on the base 9 is arranged in the location which can photo the mother base material 12.

[0088] The control apparatus 24 shown in drawing 6 has the body section 66 of a computer which held the processor, the keyboard 67 as an input device, and the CRT (Cathode Ray Tube) display 68 as an indicating equipment. The above-mentioned processor has, as shown in drawing 11 , CPU (Central Processing Unit)69 which performs data processing, and the memory 71, i.e., the information storage, which memorizes various information.

[0089] Each device of the head drive circuit 72 which drives the head positional controller 17 shown in drawing 6 , the substrate positional controller 18, the horizontal-scanning driving gear 19, the vertical-

scanning driving gear 21, and the piezoelectric device 41 (refer to drawing 10 (b)) in the ink jet head 22 is connected to CPU69 through an input/output interface 73 and a bus 74 in drawing 11 . Moreover, each device of the substrate feeder 23, an input device 67, a display 68, the electronic balance 78, cleaning equipment 77, and capping equipment 76 is also connected to CPU69 through an input/output interface 73 and a bus 74.

[0090] Memory 71 RAM (Random Access Memory), Semiconductor memory called ROM (Read Only Memory) etc., It is a concept containing external storage, such as a hard disk, a CD-ROM reader, and a disk mold storage, etc. functionally The storage region which memorizes the program software with which the control procedure of actuation of ink jet equipment 16 was described, In addition to this, the field which functions as the storage region for memorizing the horizontal-scanning movement magnitude of the slider 53 to the main scanning direction X in drawing 7 and the vertical-scanning movement magnitude of the mother base material 12 to the direction Y of vertical scanning, the work area for CPU69, a temporary file, etc., and various kinds of storage regions are set up.

[0091] By the manufacture approach of the color filter substrate of this operation gestalt, ink jet equipment 16 is used with both the color picture element formation process P3 of drawing 5 , and the protective coat formation process P4. The ink jet equipment 16 used at these processes can use the structural almost same equipment.

[0092] Moreover, the program software which regulates the whole procedure of color picture element formation in the memory 71 of drawing 11 with which the ink-jet equipment 16 used with the color picture element formation process P3 is equipped, R and G which realize color picture element arranging [which drawing 4 wishes], and B formation location data, R and the G which specify in what amount each charge of color material is supplied to each location of R, G, and B, B coating-weight data, etc. are memorized. This R and G, and B coating weight data can also be specified according to color, and can also be specified in connection with the coordinate location on the mother substrate 12.

[0093] CPU69 about the ink jet equipment 16 for color picture element formation calculates whether the regurgitation of ink, i.e., the color picture element ingredient, is carried out to either of two or more nozzles 27, and which timing during horizontal scanning of the ink jet head 22 based on R, G, B formation location data and R and G, and B coating weight data.

[0094] on the other hand, in the memory 71 of drawing 11 with which the ink jet equipment 16 used with the protective coat formation process P4 is equipped The program software which regulates the whole procedure of protective coat formation like the case of the ink jet equipment 16 used with the color picture element formation process P3, R and G which realize color picture element arranging [which drawing 4 wishes], B formation location data, R and G which specify in what amount each charge of color material is supplied to each location of R, G, and B, B coating weight data, etc. are memorized.

[0095] CPU69 about the ink jet equipment 16 for protective coat formation calculates whether the regurgitation of ink, i.e., the protective coat ingredient, is carried out to either of two or more nozzles 27, and which timing during horizontal scanning of the ink jet head 22 based on R, G, B formation location data and R and G, and B coating weight data. For example, if the case where the discharge quantity of a protective coat ingredient is decided to make almost equal the top face of a protective coat 4 and the top face of bank 5 is considered as shown in drawing 3 (a), CPU69 will compute the volume which subtracted the volume of the color picture element 3 from the volume of the grid-like hole formed of bank 5 as discharge quantity of a protective coat ingredient.

[0096] Of course, it is also possible to memorize directly whether replace with memorizing R, G, and B coating weight data as memory 71 for the ink jet equipment 16 for protective coat formation, it is made to correspond to each color picture element of R, G, and B, and the regurgitation of what amount of a protective coat is carried out concretely.

[0097] CPU69 of drawing 11 follows the program software memorized in memory 71. It is what performs control for carrying out the regurgitation of ink, i.e., a color picture element ingredient, or the protective coat ingredient to the predetermined location of the front face of the mother base material 12. As a

concrete functional implementation part The cleaning operation part which performs the operation for realizing cleaning treatment, It has the capping operation part for realizing capping processing, the gravimetry operation part which performs the operation for realizing the gravimetry using the electronic balance 78 (referring to drawing 6), and the drawing operation part which performs the operation for drawing a color picture element ingredient or a protective coat ingredient by the ink jet.

[0098] Moreover, the drawing starting position operation part for setting the ink jet head 22 to the initial valve position for drawing, if drawing operation part is divided in detail, The horizontal-scanning control operation part which calculates the control for carrying out scan migration of the ink jet head 22 at the rate of predetermined to a main scanning direction X, The vertical-scanning control operation part which calculates control only for the predetermined amount of vertical scanning to shift the mother base material 12 in the direction Y of vertical scanning, And it has various kinds of functional operation part called the nozzle regurgitation control operation part which performs the operation for controlling whether any of two or more nozzles 27 in the ink jet head 22 are operated to which timing, and the regurgitation of ink, i.e., a color picture element ingredient, or the protective coat ingredient is carried out.

[0099] In addition, although each above-mentioned function was carried out to realizing in software using CPU69 with this operation gestalt, when each above-mentioned function can be realized by the independent electronic circuitry which does not use CPU, it is also possible to use such an electronic circuitry.

[0100] It explains based on the flow chart which shows actuation of the ink jet equipment 16 which consists of the above-mentioned configuration hereafter to drawing 12 .

[0101] If ink jet equipment 16 operates by powering on by the operator, in step S1, initial setting will be performed first. Specifically, the head unit 26, the substrate feeder 23, and control apparatus 24 grade are set to the initial state decided beforehand.

[0102] Next, if gravimetry timing comes (it is YES at step S2), the head unit 26 of drawing 7 will be moved to the place of the electronic balance 78 of drawing 6 with the horizontal-scanning driving gear 19 (step S3), and the amount of the ink breathed out from a nozzle 27 will be measured using the electronic balance 78 (step S4). And according to the ink regurgitation property of each nozzle 27, the electrical potential difference impressed to the piezoelectric device 41 corresponding to each nozzle 27 is adjusted (step S5).

[0103] Next, if cleaning timing comes (it is YES at step S6), the head unit 26 will be moved to the place of cleaning equipment 77 with the horizontal-scanning driving gear 19 (step S7), and the ink jet head 22 will be cleaned with the cleaning equipment 77 (step S8).

[0104] When neither gravimetry timing nor cleaning timing comes (it is NO at steps S2 and S6), or when those processings are completed, in step S9, the substrate feeder 23 of drawing 6 is operated and the mother base material 12 is supplied to a table 49. Suction maintenance of the mother base material 12 in the substrate hold section 57 is carried out with the adsorption pad 64, next the rise-and-fall shaft 61, the 1st arm 62, and the 2nd arm 63 are specifically moved, even a table 49 is conveyed and the mother base material 12 is pushed against the gage pin 50 (refer to drawing 7) further prepared for the proper place of a table 49 beforehand. In addition, in order to prevent location gap of the mother base material 12 on a table 49, it is desirable to fix the mother base material 12 to a table 49 with means, such as air suction.

[0105] Next, observing the mother base material 12 with the camera 82 for substrates of drawing 6 , by rotating the output shaft of the theta motor 51 of drawing 7 in a minute include-angle unit, the field internal version of the table 49 is carried out in a minute include-angle unit, and the mother base material 12 is positioned (step S10). Next, an operation determines the location which starts drawing by the ink jet head 22, observing the mother base material 12 with the camera 81 for heads of drawing 6 (step S11), and the horizontal-scanning driving gear 19 and the vertical-scanning driving gear 21 are operated suitably, and the ink jet head 22 is moved to a drawing starting position (step S12). At this time,

as shown in drawing 13 , the ink jet head 22 is set so that the extension direction Z of the nozzle train 28 of each head section 20 may turn into a main scanning direction X and the direction of a right angle. [0106] If the ink jet head 22 is put on a drawing starting position at step S12 of drawing 12 , after that, horizontal scanning to the direction of X will be started at step S13, and the regurgitation of ink will be started by coincidence. The horizontal-scanning driving gear 19 of drawing 7 operates, the ink jet head 22 specifically carries out scan migration linearly at a fixed rate to the main scanning direction X of drawing 13 , during the migration, when a nozzle 27 arrives at the field which should breathe out a color picture element ingredient or a protective coat ingredient, ink, i.e., a color picture element ingredient, or a protective coat ingredient is breathed out from the nozzle 27, and this field is filled.

[0107] For example, it sets to drawing 3 (a), considering the color picture element formation process P3 of drawing 5 , and is [discharge quantity / of R color picture element 3R] VB about the discharge quantity of VG and B color picture element 3B in VR and the discharge quantity of G color picture element 3G. When it carries out, it is $VG > VR > VB$. -- -- (1)

Each color picture element is formed using the ink jet equipment 16 corresponding to each color by *****.

[0108] on the other hand -- if each color picture element 3 shall be formed as already shown in drawing 3 (a) in the state of an upper type (1) when the protective coat formation process P4 of drawing 5 is considered the object for B -- protective coat ingredient for protective coat ingredient >G for protective coat ingredient >R -- -- (2)

A protective coat 4 is formed using one ink jet equipment 16 by *****. Drawing 13 (b) shows the condition of carrying out the regurgitation of the dot-like protective coat ingredient M on them in the amount suitable for the amount of each color picture elements 3R, 3G, and 3B so that an upper type (2) may be satisfied. In addition, at this time, as shown in drawing 3 (a), a protective coat ingredient is supplied as a drop also among two or more septa 15.

[0109] In drawing 13 , after the ink jet head 22 ends one horizontal scanning to the mother base material 12 (it is YES at step S14), the inversion transfer of the ink jet head 22 is carried out, and it returns to an initial valve position (step S15). And only the die length of the amount 28 of vertical scanning which drove with the vertical-scanning driving gear 21, and was beforehand decided in the direction Y of vertical scanning, for example, the nozzle train belonging to the one head section 20, for one train, or its integral multiple moves the ink jet head 22 further (step S16). And next, horizontal scanning and the ink regurgitation are performed repeatedly, and the color picture element 3 or a protective coat 4 is formed in the field in which the color picture element 3 or the protective coat 4 is not yet formed (step S13).

[0110] if the drawing activity of the color picture element 3 by the above ink jet heads 22 or a protective coat 4 is completed to all the fields of the mother base material 12 (it is YES at step S17) -- step S18 -- the substrate feeder 23 -- or the mother base material 12 after processing is discharged by another conveyance device outside. Then, unless directions of processing termination are made by the operator (it is NO at step S19), it returns to step S2, and the ** arrival activity of the protective coat ingredient to another mother base material 12 is repeated, and is performed.

[0111] If there are directions of activity termination from an operator (it is YES at step S19), CPU69 will convey the ink jet head 22 to the place of capping equipment 76 in drawing 6 , and will perform capping processing to the ink jet head 22 with the capping equipment 76 (step S20).

[0112] By the above, patterning about each color picture element 3 which constitutes the color filter substrate 1, or patterning about a protective coat 4 is completed. If patterning about a protective coat 4 is completed, the mother base material 12 with which two or more color filter substrates 1 (drawing 1 (a)) which have the dot array of R, G, and B of a hope called a stripe array etc. were formed will be manufactured. By cutting this mother base material 12 every color filter formation field 11, two or more one color filter substrates 1 are cut down.

[0113] In addition, the laminating of an electrode, the orientation film, etc. will be further carried out to the front face of the thing which uses this color filter substrate 1 for the color display of liquid crystal

equipment, then this color filter substrate 1. In such a case, if the mother base material 12 is cut and each color filter substrate 1 is cut down before carrying out the laminating of an electrode, the orientation film, etc., formation processes, such as a subsequent electrode, will become very troublesome. Therefore, it is desirable in such a case, not to cut the mother base material 12 immediately, after the color filter substrate 1 is completed on the mother base material 12, but to cut the mother base material 12, after required addition processes, such as electrode formation and orientation film formation, are completed.

[0114] According to the color filter substrate applied to this operation gestalt as mentioned above, and its manufacture approach, in drawing 3 (a), the ingredient of the protective coat 4 supplied on two or more color picture elements 3 enters also among two or more septum 15 comrades. At this time, that rim is formed so that, as for a septum 15, the ingredient of a protective coat 4 prevents flowing into the outside of the formation field of the color picture element 3 widely, and it may stop at the place which only a uniform distance left by this, without a protective coat 4 varying to the rim of the color picture element formation field S. This result 4, for example, a protective coat, can avoid un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[0115] (The 2nd operation gestalt) Drawing 3 (b) shows the cross section of the principal part of other operation gestalten of the color filter substrate concerning this invention. This drawing shows the structure equivalent to drawing 3 (a) in the color filter substrate of the operation gestalt mentioned above.

[0116] The point that the color filter substrate 1 of this operation gestalt differs from the operation gestalt shown in drawing 3 (a) is that the top face of a protective coat 4 and the top face of bank 5 are not set as equal height, but the structure 4, i.e., a protective coat, where the top face of a protective coat 4 is higher than the top face of bank 5 is wrap structure in all the banks 5 and color picture elements 3.

[0117] The color filter substrate 1 of the ability to form by the manufacture approach shown in drawing 5 of this structure is the same as that of the case of the operation gestalt of drawing 3 (a). Moreover, the same is said of the ability to attain both the color picture element formation process P3 in the manufacture approach, and the protective coat formation process P4 by the membrane formation approach based on the ink jet method. However, it is thought that the amount of the protective coat ingredient which carries out the regurgitation from a nozzle 27 in the protective coat formation process P4 increases more than the case where the direction of the operation gestalt of drawing 3 (b) is the operation gestalt of drawing 3 (a).

[0118] Without spreading greatly, by the time it arrives at the sealant formation field U, it inclines in the shape of [loose] a taper, and, also in the case of this operation gestalt, a protective coat 4 is formed in the rim section of the color picture element formation field S. Therefore, it can prevent certainly that the seal nature of a sealant is spoiled by the protective coat 4, or the electrode formed in the front face of the color filter substrate 1 cuts in the rim part of the color picture element formation field S.

[0119] (The 3rd operation gestalt) Drawing 9 shows the example of an alteration of the head section 20 shown in drawing 8 (b). In the head section 20 shown in drawing 8 (b), the nozzle train 28 was established only for one train about the main scanning direction X. It replaces with this, the nozzle train 28 is related with a main scanning direction X in the head section 20 shown in drawing 9, and it is 2 successive-installation eclipse ***** at two or more trains and this operation gestalt. Since the regurgitation of the ink can be carried out by two nozzles 27 located in a line with that main scanning direction X when the carriage 25 of drawing 8 (a) carries out horizontal scanning in the direction of X if this head section 20 is used, -izing of the method of control of the discharge quantity of a color picture element ingredient and a protective coat ingredient can be carried out [busy].

[0120] (The 4th operation gestalt) Drawing 14 shows the main processes of other operation gestalten of the manufacture approach of the color filter substrate concerning this invention, and this process is replaced with the process shown by drawing 13 in the operation gestalt of the already explained point,

and is performed. In addition, the color filter substrate manufactured by the manufacture approach concerning this operation gestalt can be used as the color filter substrate shown in drawing 3 (a) and (b) with a sign "1." Moreover, the color filter substrate 1 can be formed by starting from the mother base material 12 shown in drawing 1 (b).

[0121] Moreover, the array of the color picture element formed in the color filter substrate 1 can be considered as various arrays, such as a stripe array shown in drawing 4 . Moreover, the process for forming the color filter substrate 1 can adopt as drawing 5 the process shown at processes P1-P4. Moreover, the ink jet equipment used in the color picture element formation process P3 and the protective coat formation process P4 can adopt the equipment of the structure shown in drawing 6 .

[0122] The point that the operation gestalt shown in drawing 14 differs from a previous operation gestalt is that the extension direction Z of six nozzle trains 28 inclines at an include angle θ to the direction Y of vertical scanning, when comparing with drawing 13 and the ink jet head 22 is put on the initial valve position to the mother base material 12, i.e., a horizontal-scanning starting position, so that clearly, and the whole carriage 25 inclines at an include angle θ to the direction Y of vertical scanning.

[0123] Since each head section 20 performs horizontal scanning in the direction of X in the state of the inclination of an include angle θ to the direction Y of vertical scanning, it can make the pitch between nozzles of two or more nozzles 27 belonging to each head section 20 in agreement with spacing of the color picture element formation field on the mother base material 12 and spacing of a protective coat formation field, i.e., the pitch between elements, according to the configuration of this operation gestalt. Thus, if the pitch between nozzles and the pitch between elements are made geometrically in agreement, since it becomes unnecessary to carry out position control of the nozzle train 28 about the direction Y of vertical scanning, it is convenient.

[0124] (The 5th operation gestalt) Drawing 15 shows the main processes of the operation gestalt of further others of the manufacture approach of the color filter substrate concerning this invention, is replaced with the process which also showed this process by drawing 13 in the operation gestalt of the already explained point, and is performed. In addition, the color filter substrate manufactured by the manufacture approach concerning this operation gestalt can be used as the color filter substrate shown in drawing 3 (a) and (b) with a sign "1." Moreover, the color filter substrate 1 can be formed by starting from the mother base material 12 shown in drawing 1 (b).

[0125] Moreover, the array of the color picture element formed in the color filter substrate 1 can be considered as various arrays, such as a stripe array shown in drawing 4 . Moreover, the process for forming the color filter substrate 1 can adopt as drawing 5 the process shown at processes P1-P4. Moreover, the ink jet equipment used in the color picture element formation process P3 and the protective coat formation process P4 can adopt the equipment of the structure shown in drawing 6 .

[0126] The point that the operation gestalt shown in drawing 15 differs from a previous operation gestalt When the ink jet head 22 is put on the initial valve position to the mother base material 12, i.e., a horizontal-scanning starting position, so that clearly, if it compares with drawing 13 , Although the whole carriage 25 does not incline to the direction Y of vertical scanning, when the six head sections 20 incline at an include angle θ to the direction Y of vertical scanning separately, it is that the extension direction Z of each nozzle train 28 inclines at an include angle θ to the direction Y of vertical scanning.

[0127] Since each nozzle train 28 performs horizontal scanning in the direction of X in the state of the inclination of an include angle θ to the direction Y of vertical scanning, it can make the pitch between nozzles of two or more nozzles 27 belonging to each nozzle train 28 in agreement with spacing of the color picture element formation field on the mother base material 12 and spacing of a protective coat formation field, i.e., the pitch between elements, according to the configuration of this operation gestalt. Thus, if the pitch between nozzles and the pitch between elements are made geometrically in agreement, since it becomes unnecessary to carry out position control of the nozzle train 28 about the direction Y of vertical scanning, it is convenient.

[0128] Moreover, since the whole carriage 25 is not made to incline like drawing 14 with this operation gestalt and it is made to make each head section 20 have inclined, compared with the case where the distance to the furthest nozzle 27 from the nozzle 27 nearest to the mother base material 12 which is a regurgitation object is drawing 14, it can do remarkably small, and, so, the time amount of horizontal scanning to the direction of X can be shortened. Thereby, the production time of a color filter substrate can be shortened.

[0129] (The 6th operation gestalt) Drawing 16 (a) shows other operation gestalten of the color filter substrate concerning this invention. Moreover, drawing 17 (b) expands and shows the part shown by the arrow head IV in drawing 16 (a). Moreover, drawing 18 (a) shows the cross-section structure according to the V-V line in drawing 17 (b).

[0130] The color filter substrate 1 shown here is formed by cutting each color filter formation field 11, after forming a pattern required in two or more color filter formation fields 11 set up in the mother base material 12 of a large area like the color filter substrate 1 shown in drawing 1 (a).

[0131] With the previous operation gestalt shown in drawing 1 (a), as shown in drawing 3 R> 3 (a), each color picture elements 3R, 3G, and 3B were supplied to the field divided by the bank 5 formed on the base material 2 by the ink jet method. On the other hand, in the color filter substrate 1 of this operation gestalt shown in drawing 18 (a), a bank is not formed, but each color picture elements 3R, 3G, and 3B open spacing mutually, the well-known patterning method, for example, photolithography method, and it is formed in a predetermined array, for example, various kinds of arrays as shown in drawing 4. And patterning of two or more septa 15 is carried out to the rim section of the color picture element formation field S at coincidence in the case of patterning of each above-mentioned color picture elements 3R, 3G, and 3B.

[0132] And after that, among each color picture elements 3R, 3G, and 3B and between septum 15 comrades, as shown in drawing 17 (a), by the ink jet method, liquid drop-like [10], i.e., a dot-like protective coat ingredient, is supplied, and baking processing or UV irradiation processing is performed further. Thereby, as shown in drawing 17 (b), a protective coat 4 is formed among each color picture elements 3R, 3G, and 3B and between septum 15 comrades.

[0133] Also in the case of this operation gestalt, since the septum 15 was formed in the rim section of the color picture element formation field S, without spreading greatly, by the time it arrives at the sealant formation field U, it inclines in the shape of [loose] a taper, and a protective coat 4 is formed in the rim section of this color picture element formation field S. Therefore, it can prevent certainly that the seal nature of a sealant is spoiled by the protective coat 4, or the electrode 13 formed in the front face of the color filter substrate 1 cuts in the rim part of the color picture element formation field S.

[0134] Drawing 18 (b) shows the example of an alteration of the operation gestalt of drawing 18 (a). Although the top face of a protective coat 4 and the top face of each color picture element 3 were equally set up with the operation gestalt shown in drawing 18 (a), with the operation gestalt shown in drawing 18 (b), the top face of a protective coat 4 is higher than the top face of each color picture element 3, namely, a protective coat 4 covers each color picture elements 3 of all. In this case, a protective coat 4 can be formed also with a spin coat.

[0135] (The 7th operation gestalt) Drawing 19 shows 1 operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention. Moreover, drawing 20 shows the cross-section structure of liquid crystal equipment where X-X-ray in drawing 19 R> 9 was followed. In addition, the liquid crystal equipment of this operation gestalt is liquid crystal equipment of the transfective reflective method which performs a full color display by the passive matrix.

[0136] In drawing 19, liquid crystal equipment 101 mounts ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive as a semiconductor chip in a liquid crystal panel 102, connects FPC (Flexible Printed Circuit) 104 as a wiring connection element to a liquid crystal panel 102, and is formed by forming a lighting system 106 in the rear-face side of a liquid crystal panel 102 as a back light further.

[0137] A liquid crystal panel 102 is formed by sticking 1st substrate 107a and 2nd substrate 107b by the

sealant 108. A sealant 108 is formed by making epoxy system resin adhere to the inside front face of 1st substrate 107a or 2nd substrate 107b annularly by screen-stencil etc. Moreover, inside a sealant 108, as shown in drawing 20, spherical or the flow material 109 formed in the shape of a cylinder is contained in the state of distribution with a conductive ingredient.

[0138] In drawing 20, 1st substrate 107a has transparent glass and tabular base material 111a formed by transparent plastics etc. The reflective film 112 is formed in the inside front face (top front face of drawing 20) of this base material 111a, the laminating of the insulator layer 113 is carried out on it, on it, 1st electrode 114a sees from arrow-head D, it is formed in the shape of a stripe (refer to drawing 19), and orientation film 116a is further formed on it. Moreover, the outside front face (bottom front face of drawing 20) of base material 111a is equipped with polarizing plate 117a by attachment etc.

[0139] Although the twist is also actually drawing those stripe spacing sharply and widely in order for drawing 19 to show the array of 1st electrode 114a intelligibly, and the number of 1st electrode 114a is therefore drawn few, as for 1st electrode 114a, an a large number book is formed more on base material 111a in fact.

[0140] In drawing 20, 2nd substrate 107b has transparent glass and tabular base material 111b formed by transparent plastics etc. A color filter 118 is formed in the inside front face (bottom front face of drawing 20) of this base material 111b, it sees from arrow-head D in the direction where the above-mentioned 1st electrode 114a and 2nd electrode 114b cross at right angles on it, and is formed in the shape of a stripe (refer to drawing 19), and orientation film 116b is further formed on it. Moreover, the outside front face (top front face of drawing 20) of base material 111b is equipped with polarizing plate 117b by attachment etc.

[0141] Although the twist is also actually drawing those stripe spacing sharply and widely like [in order for drawing 19 to show the array of 2nd electrode 114b intelligibly] the case of 1st electrode 114a and the number of 2nd electrode 114b is therefore drawn few, as for 2nd electrode 114b, an a large number book is formed more on base material 111b in fact.

[0142] In drawing 20, liquid crystal L, for example, STN (SuperTwisted Nematic) liquid crystal, is enclosed in the gap surrounded by 1st substrate 107a, 2nd substrate 107b, and the sealant 108 and the so-called cel gap. Many minute globular form spacers 119 are distributed by the inside front face of 1st substrate 107a or 2nd substrate 107b, and when these spacers 119 exist in a cel gap, the thickness of the cel gap is maintained by homogeneity.

[0143] 1st electrode 114a and 2nd electrode 114b are arranged mutually at orthogonality relation, and those crossings are seen from [of drawing 20] arrow-head D, and are arranged in the shape of a dot matrix. And each crossing of the shape of the dot matrix constitutes one picture element pixel. The color filter 118 is formed by seeing each color element of R (red), G (green), and B (blue) from arrow-head D, and making it arrange by patterns, such as a predetermined pattern, for example, a stripe array, a delta array, and a mosaic array. The one above-mentioned picture element pixel supports every one each of the them R, G, and B, and 3 color picture element pixel of R, G, and B becomes one unit, and 1 pixel is constituted.

[0144] Images, such as an alphabetic character and a figure, are displayed on the outside of 2nd substrate 107b of a liquid crystal panel 102 by making two or more picture element pixels arranged in the shape of a dot matrix, therefore a pixel emit light alternatively. Thus, the field where an image is displayed is an effective pixel field, and the superficial rectangle field shown by the arrow head V in drawing 19 and drawing 20 is an effective viewing area.

[0145] In drawing 20, the reflective film 112 is formed with light reflex nature ingredients, such as an APC alloy and aluminum (aluminum), and opening 121 is formed in the location corresponding to each picture element pixel which is the crossing of 1st electrode 114a and 2nd electrode 114b. As a result, opening 121 is seen from [of drawing 20] arrow-head D, and is arranged in the shape of [as a picture element pixel / same] a dot matrix.

[0146] 1st electrode 114a and 2nd electrode 114b are formed of ITO which is for example, transparence

electric conduction material. Moreover, the orientation film 116a and 116b is formed by making polyimide system resin adhere in the shape of [of uniform thickness] film. When these orientation film 116a and 116b receives rubbing processing, the initial orientation of the liquid crystal molecule on the front face of 1st substrate 107a and 2nd substrate 107b is determined.

[0147] In drawing 19 , 1st substrate 107a is formed in an area larger than 2nd substrate 107b, and when sticking these substrates by the sealant 108, 1st substrate 107a has substrate overhang section 107c jutted out to the outside of 2nd substrate 107b. And cash-drawer wiring 114c which prolongs for it and comes out of 1st electrode 114a to this substrate overhang section 107c, 114d of cash-drawer wiring which flows with 2nd electrode 114b on 2nd substrate 107b through the flow material 109 (refer to drawing 20) which exists in the interior of a sealant 108, It is formed by the pattern with various kinds of appropriate wiring called 114f of metal wiring connected to the bump for an input of metal wiring 114e connected to the bump for an input, i.e., the terminal for an input, of IC103a for a liquid crystal drive, and IC103b for a liquid crystal drive etc.

[0148] With this operation gestalt, 114d of cash-drawer wiring which flows in cash-drawer wiring 114c and 2nd electrode 114b which are prolonged from 1st electrode 114a is formed by ITO which is the same ingredient as those electrodes, i.e., a conductive oxide. Moreover, the metal wiring 114e and 114f which is wiring of the input side of ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive is formed, the low metallic material, for example, the APC alloy, of an electric resistance value. An APC alloy is an alloy which consists of the alloy which accompanies mainly including Ag and contains Pd and Cu, for example, Ag98%, Pd1%, and Cu1%.

[0149] IC103a for a liquid crystal drive and IC103b for a liquid crystal drive are pasted up and mounted in the front face of substrate overhang section 107c by ACF (Anisotropic Conductive Film: anisotropy electric conduction film)122. That is, with this operation gestalt, it is formed on the substrate as a liquid crystal panel of the so-called COG (Chip On Glass) method of the structure where a semiconductor chip is mounted directly. In the mounting structure of this COG method, the input-side bump of ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive and the metal wiring 114e and 114f are connected conductively, it pulls out with the output side bump of ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive, and Wiring 114c and 114d is connected conductively by the electric conduction particle contained inside ACF122.

[0150] In drawing 19, FPC104 has the flexible resin film 123, the circuit 126 constituted including the chip 124, and the metal wiring terminal 127. A circuit 126 is directly carried in the front face of the resin film 123 by the conductive connection technique of soldering and others. Moreover, the metal wiring terminal 127 is formed with the electrical conducting material of an APC alloy, Cr, and Cu and others. The part in which the metal wiring terminal 127 was formed among FPC104 is connected to the part in which metal wiring 114e and 114f of metal wiring were formed among 1st substrate 107a by ACF122. And the metal wiring 114e and 114f by the side of a substrate and the metal wiring terminal 127 by the side of FPC flow by work of the electric conduction particle contained inside ACF122.

[0151] The external connection terminal 131 is formed in the side edge of the opposite side of FPC104, and it connects with the external circuit which this external connection terminal 131 does not illustrate. And based on the signal transmitted from this external circuit, ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive drive, a scan signal is supplied to either 1st electrode 114a or 2nd electrode 114b, and a data signal is supplied to another side. Armature-voltage control of the picture element pixel of the shape of a dot matrix arranged in the effective viewing area V is carried out for each pixel of every by this, consequently the orientation of liquid crystal L is controlled for each picture element pixel of every.

[0152] In drawing 19, the lighting system 106 which functions as the so-called back light has the transparent material 132 constituted with acrylic resin etc., the diffusion sheet 133 prepared in optical outgoing radiation side 132b of the transparent material 132, the reflective sheet 134 prepared in the opposite side of optical outgoing radiation side 132b of a transparent material 132, and LED (Light Emitting Diode)136 as a source of luminescence, as shown in drawing 20.

[0153] LED136 is supported by the LED substrate 137 and the supporter (not shown) formed in a

transparent material 132 and one is equipped with the LED substrate 137. By equipping the predetermined location of a supporter with the LED substrate 137, LED136 is put on the location which counters optical incorporation side 132a which is the side side end face of a transparent material 132. In addition, the sign 138 shows the shock absorbing material for buffering the impact which joins a liquid crystal panel 102.

[0154] If LED136 emits light, the light is incorporated from optical incorporation side 132a, and is led to the interior of a transparent material 132, and while spreading reflecting on the wall surface of the reflective sheet 134 or a transparent material 132, outgoing radiation of it will be carried out from optical outgoing radiation side 132b as a flat-surface light to the exterior through the diffusion sheet 133.

[0155] In drawing 20, since it is constituted as mentioned above, it reflects by the reflective film 112 and the liquid crystal equipment 101 of this operation gestalt is again supplied to liquid crystal L, after an extraneous light is incorporated inside a liquid crystal panel 102 from the 2nd substrate 107b side and the light passes liquid crystal L, when extraneous lights, such as sunlight and indoor light, are bright enough. Orientation control of the liquid crystal L is carried out for every picture element pixel of R, G, and B with the electrodes 114a and 114b which pinch this, therefore, the light supplied to liquid crystal L is modulated for every picture element pixel, and images, such as an alphabetic character and a figure, are displayed on the exterior of a liquid crystal panel 102 by the light which passes polarizing plate 117b by the modulation, and the light which cannot pass. Thereby, the display of a reflective mold is performed.

[0156] On the other hand, when the quantity of light of an extraneous light is not fully obtained, LED136 emits light, outgoing radiation of the flat-surface light is carried out from optical outgoing radiation side 132b of a transparent material 132, and the light is supplied to liquid crystal L through the opening 121 formed in the reflective film 112. At this time, like the display of a reflective mold, it becomes irregular for every picture element pixel, and, thereby, an image is displayed on the exterior with the liquid crystal L with which orientation control of the supplied light is carried out. Thereby, the display of a transparency mold is performed.

[0157] The liquid crystal equipment 101 of the above-mentioned configuration is manufactured by the manufacture approach shown in drawing 21. In this manufacture approach, it is the process in which a series of processes of a process P1 – a process P6 form 1st substrate 107a, and is the process in which a series of processes of a process P11 – a process P14 form 2nd substrate 107b. As for the 1st substrate formation process and the 2nd substrate formation process, each is usually performed uniquely.

[0158] First, if the 1st substrate formation process is explained, will use the reflective film 112 for plurality of a liquid crystal panel 102 for the front face of the mother base material of the large area formed by translucency glass, translucency plastics, etc., and the photolithography method etc. will be formed in it. Furthermore, an insulator layer 113 is formed using the method of forming well-known on it (process P1), next 1st electrode 114a and Wiring 114c, 114d, 114e, and 114f are formed using the photolithography method etc. (process P2).

[0159] Next, orientation film 116a is formed by spreading, printing, etc. on 1st electrode 114a (process P3), and the initial orientation of liquid crystal is determined by performing rubbing processing to the orientation film 116a further (process P4). Next, for example by screen-stencil etc., a sealant 108 is formed annularly (process P5), and the still more nearly spherical spacer 119 on it is distributed (process P6). Of the above, the 1st substrate of a mother of the large area which owns two or more panel patterns on 1st substrate 107a of a liquid crystal panel 102 in part is formed.

[0160] Apart from the above 1st substrate formation process, the 2nd substrate formation process (the process P11 of drawing 21 – process P14) is carried out. First, the mother base material of the large area formed by translucency glass, translucency plastics, etc. is prepared, and the color filter 118 for plurality of a liquid crystal panel 102 is formed in the front face (process P11). The formation process of this color filter is performed using the manufacture approach shown in drawing 5, and the color picture

element formation process P3 and the protective coat formation process P4 in that manufacture approach are performed according to the control approach of the ink jet head shown in drawing 13, drawing 14, drawing 15, etc. using the ink jet equipment 16 of drawing 6. Since the manufacture approach of these color filters and the control approach of an ink jet head are the same as the already explained contents, those explanation is omitted.

[0161] If the black mask 6, bank 5, the color picture element 3, and a protective coat 4 are formed on the mother base material 12 as shown in drawing 3 (a) or drawing 3 (b) Moreover, if the black mask 6, the color picture element 3, and a protective coat 4 are formed on the mother base material 12 as shown in drawing 18 (a) or drawing 18 (b) Next, 2nd electrode 114b is formed by the photolithography method (process P12), further, by spreading, printing, etc., orientation film 116b is formed (process P13), rubbing processing is further performed to the orientation film 116b, and the initial orientation of liquid crystal is decided (process P14). Of the above, the 2nd substrate of a mother of the large area which owns two or more panel patterns on 2nd substrate 107b of a liquid crystal panel 102 in part is formed.

[0162] After the 1st substrate of a mother and the 2nd substrate of a mother of a large area are formed of the above, those mother substrates of each other are stuck [alignment /, i.e., after carrying out alignment,] on both sides of a sealant 108 in between (process P21). Thereby, the panel part for liquid crystal panel plurality is included, and the panel structure of the empty in the condition that liquid crystal is not yet enclosed is formed.

[0163] Next, a scribe slot, i.e., the slot for cutting, is formed in the predetermined location of the panel structure of the completed empty, and the panel structure is further taken a break namely, cut on the basis of the scribe slot (process P22). Thereby, the panel structure of the empty of the shape of so-called strip of paper in the condition that the opening 110 (refer to drawing 19) for liquid crystal impregnation of the sealant 108 of each liquid crystal panel part is exposed to the exterior is formed.

[0164] Then, liquid crystal L is poured into the interior of each liquid crystal panel part through the exposed opening 110 for liquid crystal impregnation, and each liquid crystal inlet 110 is further closed with resin etc. (process P23). The usual liquid crystal impregnation processing puts into a chamber etc. the reservoir container and the strip-of-paper-like empty panel by which liquid crystal was stored into for example, the reservoir container, and the liquid crystal was stored, after it makes the chamber etc. a vacua, it is immersed in a strip-of-paper-like empty panel into liquid crystal in the interior of the chamber, and it is performed by opening a chamber to atmospheric pressure after that. Since the interior of an empty panel is a vacua at this time, the liquid crystal pressurized by atmospheric pressure is introduced inside a panel through opening for liquid crystal impregnation. Since liquid crystal adheres to the surroundings of the liquid crystal panel structure after liquid crystal impregnation, the strip-of-paper-like panel after liquid crystal impregnation processing receives washing processing in a process 24.

[0165] Then, two or more liquid crystal panels are separately cut down by forming a scribe slot in a predetermined location again to the mother panel of the shape of a strip of paper after liquid crystal impregnation and washing finish, and cutting a strip-of-paper-like panel on the basis of the scribe slot further (process P25). In this way, as shown in drawing 19 to each produced liquid crystal panel 102, target liquid crystal equipment 101 is completed by mounting ICs 103a and 103b for a liquid crystal drive, equipping with a lighting system 106 as a back light, and connecting FPC104 further (process P26).

[0166] Especially concerning the liquid crystal equipment applied to this operation gestalt as mentioned above, in the color filter substrates 118 and 111b, as shown in drawing 3 (a), drawing 3 (b), drawing 18 (a), and drawing 18 (b), the ingredient of the protective coat 4 supplied between two or more color picture elements 3 and on them enters also among two or more septum 15 comrades. At this time, that rim is formed so that, as for a septum 15, the ingredient of a protective coat 4 prevents flowing into the outside of the formation field of the color picture element 3 widely, and it may stop at the place which only a uniform distance left by this, without a protective coat 4 varying to the rim of the color picture element formation field S. This result 4, for example, a protective coat, can avoid un-arranging [that enter the bottom of a sealant 108 and the seal nature of a sealant 108 deteriorates etc.].

[0167] (Other operation gestalten) although the desirable operation gestalt was mentioned and this invention was explained above, this invention is not limited to the operation gestalt, within the limits of invention indicated to the claim, is boiled variously and can be changed.

[0168] For example, although R, G, and B were used as a color picture element in the above explanation, it is not limited to R, G, and B, for example, C (cyanogen), M (Magenta), and Y (yellow) may be adopted. In that case, what is necessary is to replace with the color picture element ingredient of R, G, and B, and just to use the color picture element ingredient which has the color of C, M, and Y, if it is.

[0169] Moreover, although the six head sections 20 were formed into the ink jet head 22 with the operation gestalt explained above as shown in drawing 8 etc., the number of the head sections 20 can be made [more / that it is fewer or].

[0170] Moreover, although the case where the color filter formation field 11 of two or more trains was set up into the mother base material 12 was illustrated with the operation gestalt shown in drawing 1 (b), this invention can be applied also when the color filter formation field 11 of one train is set up into the mother base material 12. Moreover, it is the almost same magnitude as the mother substrate 12, or this invention can be applied also when only one color filter formation field 11 quite smaller than it is set up into the mother base material 12.

[0171] Moreover, although the ink jet head 22 was moved in the direction of X, horizontal scanning of the base material 12 was carried out and it decided to carry out vertical scanning of the base material 12 by the ink jet head 22 by moving a base material 12 in the direction of Y with the vertical-scanning driving gear 21 with the ink jet equipment 16 shown in drawing 6 and drawing 7, contrary to this, horizontal scanning can be performed by migration in the direction of Y of a base material 12, and vertical scanning can also be performed by migration in the direction of X of the ink jet head 22.

[0172] Moreover, although the ink jet head of the structure which carries out the regurgitation of the ink using bending deformation of a piezoelectric device was used with the above-mentioned operation gestalt, the ink jet head of the structure of other arbitration can also be used.

[0173] Moreover, although every one septum 15 was formed for every ** of the color picture element 3 with the operation gestalt shown in drawing 1 as shown in drawing 1 (a), every one septum 15 can also be formed for every number beyond every every 2three and it of the color picture element 3. Moreover, about the septum formed in the side through which electrode wiring does not pass, a septum 15 can also be formed regardless of the location of the color picture element 3.

[0174]

[Effect of the Invention] According to liquid crystal equipment, the protective coat supplied between two or more color picture elements and on them enters into the color filter substrate concerning this invention, and its manufacture approach list also among said two or more septa. At this time, a septum prevents that a protective coat flows into the outside of a color picture element formation field widely, and thereby, without that rim varying to the rim of a color picture element formation field, a protective coat is formed so that it may stop at the place which only a uniform distance left. As a result, for example, a protective coat, it is avoidable un-arranging [that enter the bottom of a sealant and the seal nature of a sealant deteriorates etc.].

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP I are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] (a) shows the top view of 1 operation gestalt of the color filter substrate concerning this invention, and (b) shows the top view of the mother substrate used as the foundation of the color filter substrate.

[Drawing 2] It is the expansion top view of the arrow-head II part in drawing 1 (a).

[Drawing 3] It is a sectional view according to the III-III line in drawing 2 (b).

[Drawing 4] It is drawing showing the example of the array gestalt of two or more kinds of color picture elements formed in the front face of a color filter substrate.

[Drawing 5] It is process drawing showing 1 operation gestalt of the manufacture approach of the color filter substrate concerning this invention.

[Drawing 6] It is the perspective view showing 1 operation gestalt of the ink jet equipment used at one process of the manufacture approach shown in drawing 5 .

[Drawing 7] It is the perspective view expanding and showing the principal part of the equipment of drawing 6 .

[Drawing 8] It is the perspective view showing 1 operation gestalt of the head section used for the 1 operation gestalt of the ink jet head used with the equipment of drawing 7 , and its ink jet head.

[Drawing 9] It is the perspective view showing the example of an alteration of the head section of an ink jet head.

[Drawing 10] It is drawing showing the internal structure of the head section of an ink jet head, and a part of (a) shows a fracture perspective view, and (b) shows the cross-section structure according to the J-J line of (a).

[Drawing 11] It is the block diagram showing the electric control system used for the ink jet equipment of drawing 6 .

[Drawing 12] It is the flow chart which shows the control flow performed according to the control system of drawing 11 .

[Drawing 13] It is the top view showing typically the main processes of 1 operation gestalt of the manufacture approach of the color filter concerning this invention.

[Drawing 14] It is the top view showing typically the main processes of other operation gestalten of the manufacture approach of the color filter concerning this invention.

[Drawing 15] It is the top view showing typically the main processes of the operation gestalt of further others of the manufacture approach of the color filter concerning this invention.

[Drawing 16] (a) shows the top view of other operation gestalten of the color filter substrate concerning this invention, and (b) shows the top view of the mother substrate used as the foundation of the color filter substrate.

[Drawing 17] It is the expansion top view of the arrow-head IV part in drawing 16 (a).

[Drawing 18] It is a sectional view according to the V-V line in drawing 17 (b).

[Drawing 19] It is the perspective view showing 1 operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention in the state of decomposition.

[Drawing 20] It is the sectional view showing the cross-section structure of liquid crystal equipment according to X-X-ray in drawing 19 .

[Drawing 21] It is process drawing showing 1 operation gestalt of the manufacture approach of the liquid crystal equipment shown in drawing 19 .

[Drawing 22] It is drawing showing an example of the conventional color filter substrate.

[Description of Notations]

- 1 Color Filter Substrate
- 2 Base Material
- 3 Color Picture Element
- 4 Protective Coat
- 5 Bank (Partition Material)
- 6 Black Mask
- 7 Color Picture Element Formation Field
- 8 Color Picture Element Ingredient
- 10 Protective Coat Ingredient
- 11 Color Filter Formation Field
- 12 Mother Base Material
- 15 Septum
- 16 Ink Jet Equipment
- 17 Head Positional Controller
- 18 Substrate Positional Controller
- 19 Horizontal-Scanning Driving Gear
- 20 Head Section
- 21 Vertical-Scanning Driving Gear
- 22 Ink Jet Head
- 25 Carriage
- 26 Head Unit
- 27 Nozzle
- 28 Nozzle Train
- 39 Ink Pressurization Object
- 41 Piezoelectric Device
- 49 Table
- 81 Camera for Heads
- 82 Camera for Substrates
- 101 Liquid Crystal Equipment
- 102 Liquid Crystal Panel
- 107a, 107b Substrate
- 111a, 111b Base material
- 114a, 114b Electrode
- 118 Color Filter
- L Liquid crystal
- M A color picture element ingredient, a protective coat ingredient
- S Color picture element formation field
- T Taper configuration
- U Sealant formation field
- W Level difference section
- X Main scanning direction
- Y The direction of vertical scanning

[Translation done.]

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.